print | export

JP2000029163 A2 Publication number:

Publication country: JAPAN

Publication type: APPLICATION Publication date: 20000128

Application number: JP19980210385 19980709

Application date:

Priority: JP19980210385 19980709;

Assigneestd:

FUJI PHOTO FILM CO LTD: ISHIZUKA TAKAHIRO : ISHIGAKI KUNIO :

Inventorstd:

International class 1-7: G03C1/498; G03C1/76;

G03C1/06 20060101 N C; G03C1/06 20060101 N A; G03C1/498 20060101 International class8:

I C : G03C1/498 20060101 I A : G03C1/76 20060101 I C : G03C1/76

20060101 I A:

European class:

G03C1/498E2; G03C1/498F; S03C1/06H; S03C1/498E2 BIN;

S03C1/498F COVL LAT:

Title: Abstract: HEAT DEVELOPABLE IMAGE RECORDING MATERIAL

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a material having high contrast, low fog and excellent adaptability for correction of an image after the heat development by using a self-crosslinking polymer latex as a binder for an

image forming layer and a protective layer. SOLUTION: A self-crosslinking polymer latex is used as a polymer latex in an image forming layer and/or a protective layer, and the proportion of the self-crosslinking polymer latex to the polymer latex component in the protective layer is =40 wt.%. As for the self-crosslinking polymer latex, a polymer latex having a poly-1,2-butadiene structure is preferably used. The polymer latex in the image forming layer is preferably incorporated by =50 wt.% of the whole binder, while the polymer latex in the protective layer is preferably incorporated by =80 wt.% of the

whole binder.

(19)日本國特許 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特期2000-29163 (P2000-29163A)

(43)公開日 平成12年1月28日(2000.1.28)

(51) Int.Cl.7		微別記号	FΙ	テーマコード(参考)
G03C	1/498		C 0 3 C 1/498	2H123
	1/76	351	1/76	151

容査請求 未請求 請求項の数5 アD (全55頁)

(21)出順番号	特贖平10-210385	(71)出版人 000005201
		富士写真フイルム株式会社
(22) 出職日	平成10年7月9日(1998.7.9)	神奈川県南足柄市中部210番地
		(72)発明者 石塚 孝宏
		神奈川県南足柄市中紹210番地 富士写真
		フイルム株式会社内
		(72)発明者 石垣 邦雄
		神奈川県南足柄市中招210番地 富士写真
		フイルム株式会社内
		(74)代理人 100082865
		弁理士 石井 陽一 (外1名)
		Fターム(参考) 2H123 AB00 AB03 AB23 AB28 BA14
		BA49 BB00 BB39 CB00 CB03

(54) 【発明の名称】 熱現像画像影録材料

(57)【要約】

【課題】 熱現像処理後の画像部のピンホールの修正適 性(オペーク適性)、さらには熱現像処理適性が良好な 熱現像画像記録材料を提供する。

【解決手段】 画像形成層および/または保護層のポリ マーラテックスとして自己架橋性ポリマーラテックスを 用いる。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に有機銀塩、遷元剤および感光 性ハロゲン化銀を含む少なくとも1層の画像形成層と、 この画像形成層上に設けられた少なくとも1層の保護層 と右方れる競用機両面をおけないさいが、

とを有する熱現像画像記録材料において、 前記画像形成層および保護層のバインダーとしてポリマ ーラテックスが用いられ、かつ、

前記画像形成層および/または保護層のポリマーラテッ クスとして自己架橋性ポリマーラテックスを用いたこと を特徴とする熱現像画像記録材料。

【請求項2】 前記保護層のポリマーラテックスとして 自己架橋性ポリマーラテックスを用いた請求項1の熱現 像画像記録材料。

【請求項3】 前記面像形成層および/または保護層の 各層のポリマーラテックス成分のうち、自己架橋性ポリ マーラテックスの合量が固形分として40重量%~10 0重量%である請求項1または20熱現像画像配鉢材 料。

「舘京項4」 前部自己架積はリマーラテックスがボ リー1、2・フクジエン構造を有するボリマーのラテックス かる6請求項1~3のいずたかの熱現処面像記録材料。 「舘求項5」 前部自己架積性ポリマーラテックスがマ レイン化ポリー1、2・ファジェンのアルカリ中和物を用い で興製されたポリマーのラテックスである請求項1~4 のいずたかの無理機面像記載材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分響】を発明は、無規を画像配慮料 料に関し、特に写真製版用に用いられ、更に詳しくは、 高コントラストの写真性を有し、かつ、 熱気度処理激性 あるいは熱現像処理後の画像部のピンホールの修正適性 (オペーク激性)が良好である無現機画像記録材料に関 する。

[0002]

【従来の技術】支持体上に感光性層を有し、画像霧光することで画像形成を行う感光材料は数多く知られている。それらの中でも、環境保全や画像形成手段が簡易化できるシステムとして、熱現像による画像を形成する技術が挙げられる。

【〇〇〇3】近年、写真製版分野において環境保全、省 スペースの関点から処理販売の減量が強く過まれてい る。そこで、レーザー、スキャー・まなはレーザー イメージセッターにより効率的に鑑光させることができ、 高階優於および雑旋使を青する維明な場合画像を形成す ることができる写真製版用途の感光性無環像材料に関す も技術が必要とされている。これら感光性熱環像材料で は、溶液系処理化学素品の使用をなくし、より簡単で環境を損ぐなない、熱気能処理レステムを観客に対して供給 することができる。

【0004】熱現像により画像を形成する方法は、例え

ば米国特許第3,152,904号、同3,457,075号、およびD. モーガン(Morgan)とB.シェリー(Shely)による「熱に よって処理される銀システム(Thermally Processed Sil ver Systems)A」 (イメージンク・プロセッシーズ・ア ンド・マテリアルズ(Imaging Processes and Material s) Neblette 第8版、スタージ(Sturge)、V. ウォール ワーズ(Walworth)、A、シェップ(Shepp)編集。第2 頁、1969年)に記載されている。このような感光材料 は、 還元可能な非感光性の銀源 (例えば有機銀塩)、 軸 媒活性量の光触媒(例えばハロゲン化銀)、および銀の 還元剤を通常有機バインダーマトリックス中に分散した 状態で含有している。感光材料は常温で安定であるが、 露光後高温(例えば80℃以上)に加熱した場合に、還元 可能な銀源(酸化剤として機能する)と還元剤との間の 酸化濁元反応を通じて銀を生成する。この酸化濁元反応 は露光で発生した潜像の触媒作用によって促進される。 露光領域中の還元可能な銀塩の反応によって生成した銀 は黒色画像を提供し、これは非露光領域と対照をなし、 画像の形成がなされる。

[0005] 総歩から、これらのタイプの熱球爆感光材 料は知られているが、これらの多くはトルエン、メチル エチルクトン、メタノールなどの有機構剤と溶接しする 途布剤を接合することにより熱理保証関厚を形成してい る、有機溶剤を効果として削らことは、製造工の 人体への悪影響、地球温暖化の原因ともなる有機系がス の辨出の問題があり、更に溶液回収、防爆熱酸の必要な どコスト面でもあり、更に溶液回収、防爆熱酸の必要な どコスト面でもあり、更に溶液回収、防爆熱酸の必要な とコスト面でもあり、

[0006] このような問題は塗布溶剤に水を用いることで解於できる。(以降塗布溶剤に水を用いた塗布方式を「水系塗布」と表す。) 例えば、特問昭49-52626号、特問昭59-1614号をとにゼラチンパインダーを用いた例が記載されている。また、特開昭59-15133号にはボリビニルアルコールをバインダーとする例が記載されている。

【0007】しかし、このような水溶性パインダーの使用は熱現集時にバインダーの膨水収縮と熱膨張が同時に起こり、支持体の熱膨張と吸ぐるためにフィルムにシワが発生し、重ね合わせて使用するカラー印刷には不適当なフィルムしか得られない。

[0008] この問題は、ポリマーラテックスを用いる ことで解決できる。例えば、WO97-4955号、特開平6-137 045号などにパングーとしてポリマーラテックスを用 いて水系統布により無現集画像記録材料を作成する方法 が配数されている。

【0009】しかしをがら、写真性を接込みずに歩ーに 高級形成関急よび保護層を形成するためには、MFT (最低造態温度)の低いポリマーラテックス整心液を用 いる必要があり、そのためには、Tg (ガラス配粉組 度)の低いポリマーラテックスおよびゲメまたは造態助所 を用いて、適当なMFTで強心膜を形成させることが必 須である。しかし、MFTを下げることは、協商総規後 の遠膜を歌葉化し、熱現後処理時に熟現環機部材(例え 、搬送ローラー、ガイド政をど)と栄養して護地不良 を起こしたり、籍り傷がつきやすいなどの問題を起こし やすい。また、無現保処理信念の画像のピンホールの修正 に、しばしば部線に市機等制度でいる能で設か使用され る。これらの修正液を用いた場合。修正部分の途膜が落 解したり、非常に大きく影別して面像を損なうことがあ る。

【0010】一般に、ポリマーの耐熱性、耐火性の向上、機能的性質の改良の目的で、種々の率認利を別いて、ポリマーを実施する技術が行われている。これらの技術は、一般に、高温で実施するさながない。症状を見れて、カンリが高く、硬部化し難いなどの問題があった。また、実施別には活性大楽と反応するものが多く(例え、エポキシ基をど)、保護原で収集制を加えた場合でも、並依により質を形成に必要な素剤とも反応してしまい写真性能が低下する問題があった。写真物性を損な力すに、実験が進行し、熱現現処理選性、あるいは、無現保後の関係の新正強性に優れた無理機能が解析が成められている。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】本発明が解決しようと する課題は、写真製版用、物に、スキャナー、イメージ セッター用として高コントラストでカブリが低い良好な 写真特性が得られ、かつ、発現像後の面接の修正査性 イオペーク連性)に優れ、さらには、熱現像処理遺性に 優れた無現集團能記録材料を提供することである。 [0012]

【課題を解決するための手段】この課題は、下記手段に よって達成された。

- (1) 支持体上に有機銀塩、選売制および感光性ハロ シン化銀を含む少なくとも1層の両限影成階と、この画 施形成階上に限けられた少なくとも1層の限限制度とを有 する熟現集師成里線材料において、前証前像形成階およ の低鍵層のパンダーとして30マラテックよが用い られ、かつ、前記両像形成階および/または保護層のボ リマーラテックスととなって自己実際性がリマーラテックス を用いたことを確とする影視機能が見ず料料。
- (2) 前紀保護層のボリマーラテックスとして自己架 橋性ボリマーラテックスを用いた上記(1)の熱現像画 像記録材料。
- (3) 前記画係形成層および/または保暖層の各層の ボリマーラテックス成分のうち、自己架橋性ボリマーラ テックスの含量が固形分として40重星%~100重量 %である上記(1)または(2)の熱現復画像記録材 料。
- (4) 前記自己架橋性ポリマーラテックスがポリー1,2-ブタジエン構造を有するポリマーのラテックスである

上記(1)~(3)のいずれかの熱残傷画像形飾材料。 (5) 前記自己課題性ポリマーラテックスがマレイン 化ポリース・アダンシエンのアルカリキ和物を用いては はポリスークのテックスである上記(1)~(4) のいずれかの熱現負責後記録材料。 [9013]

【発明の実施の形態】以下に本発明を詳細に説明する。 本発明の熱現像画像記録材料は、有機銀塩と還元剤と感 光性ハロゲン化銀とを含有する画像形成層を有し、この 画像形成層上に保護層を有するものであり、画像形成層 および保護層のバインダーとして、環境面、コスト面で 有利な水系途布が可能になるボリマーラテックスを用い ている。このような熱現像画像記録材料において、画像 形成層および/または保護層(好ましくは保護層)のポ リマーラテックスとして自己架橋性ポリマーラテックス を用いることによって、良好な写真性能を維持したまま で、オペーク適性に優れた熱現像画像記録材料が得られ る。そして、さらに保護層のポリマーラテックス成分 (固形分) に対する自己架橋性ポリマーラテックス (固 形分)の比を40重量%以上とすることによって熱現像 処理適性が良好になる効果が得られる。また、オペーク 適性および熱現像処理適性に優れるという効果は、自己 架橋性ポリマーラテックスとしてポリー1、2-ブタジ エン構造を有するポリマーラテックスを用いることによ って、さらに向上する。

【0014】これに対し、ポリマーラテックスとして自己架橋性ポリマーラテックスを用いないと、本発明の効果は得られない。

【0015】本発明の画像形成層に用いられるポリマー ラテックスは、全バインダーの50重量%以上であるこ とが好ましい。また、本発明の保護層に用いられるポリ マーラテックスは全バインダーの80重量%以上である ことが好ましい。また、ポリマーラテックスは画像形成 層および保護層だけでなく、バック層に用いても良く、 特に寸法変化が問題となる印刷用途に本発明の熱現像画 像記録材料を用いる場合には、ポリマーラテックスを用 いる必要がある。ただし、ここで言う「ポリマーラテッ クス」とは水不要な疎水性ポリマーが微細な粒子として 水溶性の分散媒体中に分散したものである。分散状態と してはポリマーが分散媒体中に乳化されているもの、乳 化重合されたもの、ミセル分散されたもの、あるいはボ リマー分子中に部分的に親水的な構造をもち分子鎖自身 が分子状分散したものなど何れでも良い。分散粒子の平 均粒径は1~50000nm、より好ましくは5~1000nm程度 の範囲が好ましい。なお、粒径は下記刊行物記載の光散 乱法で求めた場合である。分散粒径の粒径分布に関して は特に制限はなく、広い粒径分布を持つものでも単分散 の粒径分布を持つものでもよい。なお、ポリマーラテッ クスについては「合成樹脂エマルジョン(奥田平、稲垣 寛編集、高分子刊行会発行(1978))」、「高分子ラテッ クスの化学(室井宗一著、高分子刊行会発行(1970))」 などに記載されている。

【0016】本発明の自己架積性ポリマーラテックスとは、架橋前を添加することなしに、途布造機後に60℃
は、架橋前を添加することなしに、途布造機後に60℃
である。本発明において面破疾成層あるいは保護順に耳いる自己架間性ポリマーラテックスの合量は、国際分と
い、(に脚ポリマーラテックスの合量は、国際分とい。(に脚ポリマーラテックスのクをはディリカーラテックスでないポリマーラテックスを特に示場合には「非自己架路性ポリマーラテックスを特に示場合には「非自己架路性ポリマーラテックスとないポリマーラテックスとない。「0017】本売明に用いるポリマーラテックスとしては温常の場一様のポリマーラテックスとしてシェル型のラテックスとしては一部のポリスを表す。)

[0018]本売明のバインゲーに用いるボリマーラテックスのポリマーのTg(ガラス底砂温度)は保護限、バック度ご面接形成屋とでは対ましい範囲が異なる。間像形成屋にあっては熱現像時に写真有用素材の鉱散を促すため、40℃以下であり、さらには一30~40℃が好ましい。保護層やバック層に用いる場合には種々の機器と接触するため25~70℃が好ましい。

【0019】本発明のポリマーラテックスのMF「食 応強機進度)は一30~90℃、より好ましくは0~7 0で健康が算ましい。MFTをコントロールするために 油限助剤を添加しても良い。 遠限助剤は可認剤ともよば れポリマーラテックスのMFTを近下させる有機化合物 (適常有機溶剤)で、例えば前述の「高分子ラテックス の化学(意井承・春、高分子刊行会発行(1970))」に記 載されている。

[0020]本発明のポリマーラテックスに用いられるポリマー圏としてはアクリル樹脂、酢酸とエル機脂、ボリエスアル樹脂、ボリカレタン樹脂、スム系機脂、塩化ビニル砂脂、塩化ビニルでは、カース・ボリスーとしては直痕のボリマーでも良かれしたボリマーでも、また、架線を打たボリマーでも良い、また、ボリマーとしては単一のセノマーが重合したソルウストボリマーでも良いし、2種以上のモノマーが重合したコボリマーでも良い、ボリマーの分子並は数平均分子量で5000~1000である。分子量が1000~1000である。

【0021】本発明の画像形成層は全バインゲーの50 重量%以上としてポリマーラテックスを用いることが好ましいが、70重量%以上として上記ポリマーラテック スを用いることが特に好ましい、保護層は全バインダー の80量%以上としてポリマーラテックスを用いること が好ましいが、90重量%以上として上記ポリマーラテ ックスを用いることが特に好ましい。

【0022】本発明のバインダーとして用いられるボリ マーラテックスのうち、非自己架橋性ポリマーラテック スの具体例としては以下のようなものがある。メチルメ タクリレート/エチルアクリレート/メタクリル酸コポ リマーのラテックス、メチルメタクリレート/2-エチ ルヘキシルアクリレート/スチレン/アクリル酸コポリ マーのラテックス、スチレン/ブタジエン/アクリル酸 コポリマーのラテックス、スチレン/ブタジエン/ジビ ニルベンゼン/メタクリル酸コポリマーのラテックス、 メチルメタクリレート/塩化ビニル/アクリル酸コポリ マーのラテックス、塩化ビニリデン/エチルアクリレー ト/アクリロニトリル/メタクリル砂コポリマーのラテ ックスなど。また、このようなポリマーは市販もされて いて、以下のようなポリマーが利用できる。例えば、ア クリル樹脂の例として、セビアンA-4635、4601(以上ダ イセル化学工業(株)製)、Nipol Lx811、814、821、8 20、857(以上日本ゼオン(株)製)など、ポリエステ ル樹脂としては、FINETEXES650、611、675、850(以上 大日本インキ化学 (株) 製)、WD-SIZE、WMS (以上イー ストマンケミカル (株)製) など、ポリウレタン樹脂と しては、HYDRAN AP10、20、30、40(以上大日本インキ 化学 (株) 製) など、ゴム系樹脂としては、LACSTAR 73 10K、3307B、4700H、7132C(以上大日本インキ化学 (株) 製)、NipolLx416、410、438C、2507(以上日本 ゼオン (株)製)など、塩化ビニル樹脂としては、G35 1、G576 (以上日本ゼオン (株) 製) など、塩化ビニリ デン樹脂としては、L502、L513(以上担化成工業(株) 製)、アロン D7020、D504、D5071(以上三井化学 (株) 製) など、オレフィン樹脂としては、ケミパール S120、SA100 (以上三井化学(株)製)などを挙げるこ とができる。これらのポリマーは単独でも良いし、必要 に応じて2種類以上プレンドして用いても良い。 【0023】本発明のバインダーとして用いられるボリ マーラテックスのうち、自己架橋性ポリマーラテックス の具体例としては以下のようなものがある。メチルメタ クリレート/エチルアクリレート/N-メチロールアク リルアミドコポリマーのラテックス、メチルメタクリレ ート/N-メチロールアクリルアミドコポリマーのラテ ックス、ブチルアクリレート/N-メチロールアクリル アミドコポリマーのラテックスなどのN-メチロール基 を含有するポリマーのラテックス、マレイン化ポリー1. 2-ブタジエン存在下に1種類以上のビニルモノマー

(例えば、メチルメタクリレート、エチルメタクリレー

ト、ブチルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、

2-エチルヘキシルメタクリレート、アリルメタクリレ

ート エチレングリコールジメタクリレート等のメタク

ト、ブチルアクリレート、ヘキシルアクリレート、2-

エチルヘキシルアクリレート、アリルアクリレート等の

リレート類、メチルアクリレート、エチルアクリレー

アクリレート類、アクリル酸、メタクリル酸、イタコン 酸等のカルボキシル基含有ビニルモノマー類、アクリア ミド、メタクリルアミド等のアミド基含有ビニルモノマ 一類、スチレン、4-メチルスチレン、スチレンスルホ ン酸、ジビニルスチレンなどのスチレン類など、塩化ビ ニル、塩化ビニリデン等のハロゲン化エチレン類、酢酸 ビニル、プロピオン酸ビニル等のビニルエステル類、エ チレン、ブタジエンなどの重合性炭化水素)を重合した ラテックスなどのポリ-1,2-ブタジエン構造を含有す るポリマーのラテックスを挙げることができる。なかで もポリー1,2-ブタジエン構造を含有するポリマーの ラテックスが好ましく、マレイン化ポリー1、2ープタ ジエンのアルカリ中和物を用いて合成されたものである ことが好ましい。これらの具体的な合成法については、 特公昭51-25075号等を参照することができる。 これらのボリマーは単独でも良いし、必要に応じて2種 類以上プレンドして用いても良い。

[0024]本発明の画像形成層および/または保護層 に用いるボリマーラテックス (固形分) に占める自己架 橋性ボリマーラテックス (固形分) の割合は、各層中に おいて、40重量%~100重量%が好ましく、より好 ましくは60重量%~100重量%である。

[0025] 本売明のパインゲーにはポリマーラテック

ズに由来するもの別かのパインゲーとして、ポリビニル
アルコール、ポリビニルビロリドン、ポリエーテル、ウ
レア・ボルムアルデレド随難、セルロース海線体(メチ
キシメチルセルロース、トドロキンプロビルルロース、カルボ
キシメチルセルロース、セル
ロースアセテートなど)、ポリアクリルアミド、ポリド
ーアルキル電振アクリルアミド、ポリド
・バリアクリル酸、ポリビニルスルオン酸、ポリビニルイミ
ダゲール、カラシーナン、ベクテン、アミロース、スク
ーチ酸薬体、アルギンは、アルラン、ゼラチンなどの観
水性ポリマーを必要に応じて添加しても臭い、これらの 観水性ポリマーの添加量は面膜形成間で金パインゲーの 50重要な灯下が穿ました、保護層は全パインゲーの 6番似日下であることが発生しい。

[0026] 本祭明の画味財成層旅市液の溶媒(分散物)
の604以上 [10044 以下)、本界別の福麗性の 溶媒(分散線)の804以上 [10044 以下) は木であるこ とが容ましいが、遠布液の水以りの接付はメチルアルコ ル、エチルアレコール、イソフロじアルコール、 チルセロソルブ、エチルトセロソルブ、ジメチルネルムア ミド、副輸出チルウとどの水温和性の有機溶媒を用いるこ とができる。具体的と溶媒構成の例としては、木のほ か、以下のようなものがある。水/メタノールー90/10、 木/メタノールー70/20、水/エタノールー90/10、 木/イソアロバノールー90/10、木/ジメチルホルムアミドー90 (15/5、木/メタノール/ジメチルホルムアミドー90 (15/5、木/メタノール/ジメチルホルムアミドー90 /5/5。(ただし数字はwt%を表す。)

【0027】本発明の保護層用の全バインダー量は0. 2~5.0g/m²、より好ましくは0.5~3.0g/m²の範囲が好ましい。

【0028】本発明の画像形成層用の全バインダー量は 0.2~30g/m²、より好ましくは1.0~15g/m² の範囲が好ましい。

【0029】本発明のバック層用の全バインダー量は 0.01~3g/m²、より好ましくは0.05~1.5g/m²の範囲が好ましい。

【0030】それぞれの層には架橋のための架橋剤、塗 布件改良のための界面活性剤などを添加してもよい。

【0031】 これらの各層は、2層以上戦けられる場合 がある。 画像形版層が2層以上である場合は、すべか がある。 画像形版層が2層以上である場合は、すべか が存ましい。また、保護層に画像形成層上に殴けられる 居で約2層以上在する場合もあるが、少なくか 日本ことが好ましい。また、パック層は支持体のパック 画の可能り層の上部に殴けるれる層であり2層以上存在 する場合もあるが、少なくとも1層、特に扱外層のパッ ク層に対りマーラテックスを押いるととが好ましい。 【0032】本郷界の無限無個能記録付料には、程々の 支持体を用いることができる。典型的な支持体は、ボリ エチレンテレフクレート、ボリエチレンナフタレート、 をどのボリエステル、研修セルロース、セルロースエス やル・ボリビステル、研修セルロース、セルロースエタ ル・ボリエーチンル・フィース・セルロースエタール、ボリビスルア・タート。

合む。このうち二輪延伸したポリエステル、特にポリエ チレンテレフタレート (PET) は強度、寸法安定性、 緊痛組作をとかったがましい。支持体の遅みは下途り 層を除いたペース厚みで90~180μmであることが 打ましい。 (0033) 本発明の熱張後面縁配縁材料に用いる支持

株は二難師神時にフィルム村に残存する内部部入を緩和 させ、無現像中に発生する影収箱部みを無くすために、 130~210℃の温度細度で熱処理を施したポリエス テル、特にポリエチレンテレフタレートが好ましく用い られる。このような無板が処理は温度新囲りの一定温度 で実施してもよく、月温しながら実施してもよい。 [0034] 支持権の熱処理はコール状で実施してもく、ウェンガ状で搬送しながら実施してもよい、ウエッ

く、ウエッフ状で徹底しなから実施してもよい。ウエッフ状で徹底しなから実施する場合、発処理時の支持体の 搬送張力を7kg/cm²以下、特に4、2kg/cm²以下にす ることが好ましい。このときの機送張力の下限には特に 初限はないが0.5kg/cm²程度である。

【0035】このような熟処理は、支持体に対する画像 形成層やバック層の接着性を向上させるための処理、例 えば下塗り層の設層等を施した後に行うことが好まし い。

【0036】このような熱処理後における支持体の12

0℃30秒加熱による熱収縮率は維方向(MD)が− 0.03%~+0.01%、機方向(TD)が0~0. 04%であることが好ましい。

[0037]支持体は必要に応じてSBR、塩化ビニリデン、ポリエステル、ゼラチン等をバイングーとする下 塗り層を塗布してもよい、下空り層は多層機変としても よく、また支持体に対して片面または両面に設けてもよ く、これら下途り周の少くくも一層を帯電量ですることができる。下途り房の一般的呼入は0.01~5μm 、より好ましくは0.05~1μm であってよく、導 電間とするときの厚利は0.01~1μm、より好まし くは0.03~0.8 μm である。

[0098]本発明の熱現極重像記録材料の支持体に隣接するバック層。または下盤)圏中には、ごも付着を減りやさせるために金属機化物が含有されていることが好ましく、バック層さよび下途り層(支持体の両面に設けられるもの)のうちの少なくとも1層を審電艦とすることが好ましい。ただし、築電環は最外層のバック層でない方が好ましい。

【0039】ここで、用いられる金属酸化物は特開昭61 -20033号、同56-82504号公報に記載されているものが特に好きしい。

【0040】本発明の導電性金属酸化物の使用量は、画 像記録材料1㎡当たり0.05~20gが好ましく、特 に0.1~10gが好ましい。金属酸化物含有層の表面 抵抗率は25℃25%RHの雰囲気下で10㎡Ω以下

C₃H₇ F-2 C₈F₁₇SO₂N —CH₂COOK

F-5 CaF₁₇SO₃Li

[0045] 本発明か合ファ素料面活性操作液度する層 は画像記載材料のかなくとも1層でおれば特に限定され が、例えば表面保護機、乳利側、中間層、下値り解、パック層などを挙げることができる。その中でも哲ましい 鉱加場所としては来面保護機であり、画像形成開始もし くにバック層側のどあの一方でもよいが、少なくとも 画像形成層側の表面保護層で添加した場合はさるに好ま で、好ましくは10¹¹Ω以下がよい。これにより良好な 帯電防止性が得られる。このときの表面抵抗率の下限は 特に制限されないが、通常10⁷Ω程度である。

【0041】本発明においては、上記金属酸化物の他 に、さらに含フッ素界面活性剤を併用することによって さらに良好な帯電防止性を得ることができる。

【0042】本売例に用いられる好ましいきフッ素界面 活性用としては、炭素数4以上(通常15以下)のフル オロアトルルを、クルオロアルクエル基。またはラルオ ロアリール基を有し、イオン性基としてアニオン基(ス ルホン酸(塩)、硫酸(塩)、カルボン酸(塩)、リン (塩)、がオン基(アンモニアウム塩、 芳香族アミン塩、スルホニウム塩、ホスホニウム塩)、 ベタイン基(の水柱キツ下を24、カルボキンア・モニ ウム塩、スルホアミン塩、スルホアンモニウム塩、ホス ホアンモニウム塩、または、ニオン苦(塩臭、細菌製 のポリオキシアトキレン塩、ボリウリモリル産業をはソ ルビタン提高)を育る原面活性制が繋が与れる。

【0043】これらの含ファ素界面活性和は特開昭49-1 0722号、東国特許第1303,356号、米国特許第4,335,201 号、両4,347,308号、英国特許第4,479,15号、特開昭55 -149938号、同58-196544号、英国特許第1,439,402号な どに記載されている。これらの具体例のいくつかを以下 に許す。

【0044】

+CH₂CH₂O }4 +CH₂ }4 SO₃Na

CV.

【0046】表面保護層が2層以上から成る場合はそのいずれの層でもよく、また表面保護層の上にさらにオーバーコートして用いることもできる。

【0047】本発明の含フッ素界面活性剤の使用量は画 像記録材料の1≈当たり0.0001~1gであればよ いが、より好ましくは0.0002~0.25g、特に 好ましいのは0.0003~0.1gである。 【○048】また 木登班の今フッ委集而活体和は

【0048】また、本発明の含フッ素界面活性剤は、2 種以上混合してもよい。

【0049】本発明におけるベック平清度は、日本工業 規格(JIS) P8119 新および版派のベック試験 器による平滑度試験方法」およびTAPPI標準法T4 79により容易に求めることができる。

[0050]本野野の熱理衛衛監証結材料の面接財政党を育する面対よびその反対面の最外指表面の少なくとも一方、好法とくは両方のペッタ平階度は、2000秒以下であり、より貸ましは10秒~2000秒である。「0051]券収慮値能認体が内の電影が匿を有する面の思外開表面がよびその反対国の最外層表面のペック平消度は、前記面前の場合となるで、外別生格される微粒子の子均粒を含まびができる。マット和は簡優形成層を有する配とがいては支持体から最も動れた最份機関を有する配とができることが考まし、その反対側においては最外層となる保護層に含有させることが好ましく、その反対側においては最外層でないバック層に含有させることが好ました。その反対側においては最外層でないバック層に含有させることが好ましく、その反対側においては最外層でないバック層に含有させることが好ましく。その反対側においては最外層でないバック層に含有させることが好ました。

【0052】本発明において好ましいマット剤の平均粒 径は、1~10μmの範囲である。

【0053】本発明において好ましいマット剤の添加量は、5~400mg/m²、特に10~200mg/m²の範囲である。

[0054] 本発明に用いられるマット 和は、享集的館 特性に駆影響を及ぼさない配体性子であれば、たりま なものでもよい、無機系のマット剤としては、二酸化ケ イ素、チタンおよびゲルミニウムの酸化物、亜鉛および カルウウムの対数性、パリウムおよびがルッシュムの破 塩、カルシウムおよびゲルミニウムのケイ酸性など、有 機系のマット剤としては、セルロースエステル環、ボリ メチルメタクリレート、ポリスチレンまたはポリジビニ ルベンゼンおよびごれらのコポリマーなどの有領重合体 のマット剤が単げられる。

[0055]本発明では、特開で3-109542分級2頁左 下欄8行目~3頁右上欄4行目に記載された多孔性のマ ット剤、特開呼4-127142号公路3頁右上欄7行目-5頁 右下隣4行に記載されたアルカリで表面修飾したマット 剤、特開平6-11852号や級の原務香号「0005」から 「0026」に記載された有機電合体のマット剤を用い ることがより好ましい。

 よび/またはその反対面の最表面層に滑り剤を含有させ ることが好ましい。

【0058】本発明における滑り剤とは、特に制限はな く物体表面に存在させた時に、存在させない場合に比べ て物体表面の摩擦層数を減少させる化合物であればいず れでもよい。

【0059】本郊野に用いられる清ク新の代表的文ともの としては例えば死時神済か。302、2079、鬼江時時5 5,061号、米江特許前3,080,317号、同東4,004,927号、 同海4,004,959号、同海3,489,567号、英国特許第1,143, 118号等に北郊のシリコーン系符の別、米取時計済、143, 148号、両第2,732,959号、同第2,956,168号、同第3,2 4,043号、両第2,732,959号、同第2,204,294号等 展記数の高級監証施展、アルコール系、該アミド系符り 別、延即時計第1,263,722号、米昭時計済。393,516号等 正記数の高級に付し、米宝時計済、288,765号、同第3,1 21,060号、英国特計第1,198,387号等に記載のエステル 系、ナーナル系符り割、米田時計済5,502,473号、同第3, 404,222号と記載のクラリン系が、判轄があ5,502,473号、同落 3,042,222号と記載のクラリン系が、判轄があ5,502,473号、同高

【0060】 哲ましく用いられる清り剤の具体例としては、セロゲール524(主般分カルナパマックス)、ボリロンA、393、H-481(主成分ポリエナシックス)、ハイミクロンG-110(主成分エチレンビスステアリン散アマイド)、ハイミクロンG-270(主成分ステアリン散アマイド)(以上、中京油館(株) 製)などがある。

【0061】滑り剤の使用量は添加層のパインダー量の 0.1~50重量%であり、好ましくは0.5~30重量%である。

【0062】本発明に用いられる感光性ハロゲン化銀 は、塩化銀、塩臭化銀、ヨウ塩臭化銀のいずれでもよ い。また、粒子内におけるハロゲン組成の分布は均一で あってもよく、ハロゲン組成がステップ状に変化したも のでもよく、あるいは連続的に変化したものでもよい。 【0063】本発明における感光性ハロゲン化銀の形成 方法は当業界ではよく知られており例えば、リサーチデ ィスクロージャー1978年6月の第17029号、および米国特 許第3,700,458号に記載されている方法を用いることが できる。本発明で用いることのできる具体的な方法とし ては、調製された有機銀塩中にハロゲン含有化合物を添 加することにより有機網集の銀の一部を廃光性ハロゲン 化銀に変換する方法、ゼラチンあるいは他のポリマー溶 液の中に銀供給化合物およびハロゲン供給化合物を添加 することにより感光性ハロゲン化銀粒子を調製し有機銀 塩と混合する方法を用いることができる。本発明におい て好ましくは後者の方法を用いることができる。感光性 ハロゲン化銀の粒子サイズは、画像形成後の白濁を低く 抑える目的のために小さいことが好ましく具体的には0. 20μm以下、より好ましくは0.01μm以上0.15μm以下、 更に好ましくは0.02μm以上0.12μm以下がよい。ここ

でいう粒子サイズとは、ハロゲン化銀粒子が立方体ある いは八面体のいわゆる正常品である場合にはハロゲン化 銀粒子の稜の長さをいう。また、ハロゲン化銀粒子が平 板状粒子である場合には主表面の投影面積と同面積の円 像に換算したときの直径をいう。その他正常品でない場 合、例えば球状粒子、棒状粒子等の場合には、ハロゲン 化銀粒子の体積と同等な球を考えたときの直径をいう。 【0064】ハロゲン化銀粒子の形状としては立方体。 八面体、平板状粒子、球状粒子、棒状粒子、ジャガイモ 状粒子等を挙げることができるが、本発明においては特 に立方体状粒子、平板状粒子が好ましい。平板状ハロゲ ン化銀粒子を用いる場合の平均アスペクト比は好ましく は100:1~2:1、より好ましくは50:1~3:1がよい。更 に、ハロゲン化銀粒子のコーナーが丸まった粒子も好ま しく用いることができる。感光性ハロゲン化銀粒子の外 表面の面指数(ミラー指数)については特に制限はない が、分光増整色素が吸着した場合の分光増感効率が高い (100) 面の占める割合が高いことが好ましい。その割合 としては50%以上が好ましく、65%以上がより好ましく、 80%以上が更に好ましい。ミラー指数(100)面の比率は増 感色素の吸着における (111) 面と (100) 面との吸着依存性 を利用したT. Tani: J. Inaging Sci.. 29 165(1985年)に記 戯の方法により求めることができる。

【0065】本寿明の恋光性ハロゲン化協設予は、周期 株表の郷YII 抹あるいは第VII は、係了族・高10族) の金属または金属場体を含有する。周期除表のWII 族 あるいは郷YII 鉄か企属または金属場体の中心金属として では、イリジウムである。これら金属場体は1種類でも よいし、同種金属および異種金属の端体を二種以上併用 してもよい、好ましい含有率は銀11・Ky対しルモルか 510モルの地間が好ましく、100モルから100ルの 地間がより好ましい。具体的な金属場体の構造としては 特制でアー20249号率に記載された構造の金属端体を用い ることができる。

[0066] 本発明に用いられるロジウム化合物としては、水溶性ロジウム化合物を用いることができる。例えば、ハロゲン化ロジウム(III)化合物、またはロジウム錦電で配位子としてハロゲン、アミン類、オキザラト・

[0072] これらの化合物の添加量はNロゲン化線1 モル当たり 1×10^{-8} モル -1×10^{-8} モルの転囲が好ましく、特に好ましくは 1×10^{-8} モル -1×10^{-6} モルである。 等を持つもの、例えばヘキサクロロロジウム(III)錯 塩、ペンタクロロアコロジウム(III)錯塩、テトラク ロロジアコロジウム (III) 錯塩、ヘキサブロモロジウ ム (III) 錯塩、ヘキサアンミンロジウム (III) 錯塩、 トリザラトロジウム (III) 錯塩等が挙げられる。これ らのロジウム化合物は、水あるいは適当な溶媒に溶解し て用いられるが、ロジウム化合物の溶液を安定化させる ために一般によく行われる方法、すなわち、ハロゲン化 水素水溶液(例えば塩酸、臭酸、フッ酸等)、あるいは ハロゲン化アルカリ (例えばKC1、NaC1、KB r、NaBr等)を添加する方法を用いることができ る。水溶性ロジウムを用いる代わりにハロゲン化銀調製 時に、あらかじめロジウムをドープしてある別のハロゲ ン化銀粒子を添加して溶解させることも可能である。 【0067】これらのロジウム化合物の添加量はハロゲ ン化銀1モル当たり1×10-8モル~5×10-6モルの 範囲が好ましく、特に好ましくは5×10-8モル~1× 10-6モルである。

【0068】これらの化合物の密加は、ハロゲン化燃乳 和粒子の裏造時および乳剤を塗布する前の各段階におい て適定行うことができるが、特に乳剤物成物に応加・ ハロゲン化銀粒子中に組み込まれることが好ましい。 (0669】本粉形にみられるシェンカム、ルチェンム、 オスミング は特勝限紀・2042号、特開平1-285941号、 同2-2052号、同2-2055号等に配載された水溶性銀藻の 形で添加される、特に昇ましいものとして、以下の式で 示される大配位銀件が挙げられる。

ここでMはRu、Re、またはOsを表し、しば配位子 を表し、nはO、1、2、3または4を表す。この場 合、対イオンは重要性を持たず、アンモニウムもしくは アルカリ金属イオンが用いられる。

[0070]また好ましい配位子としてはハロゲン化物 配位子、シアン化物配位子、シアン酸化物配位子、ニト ロシル配位子、チオニトロシル配位子等が挙げられる。 以下に本売明に用いられる具体的錯体の例を示すが、本 発明はこれに限定されるものではない。

[0071]

> 【0073】これらの化合物の添加は、ハロゲン化銀乳 剤粒子の製造場および乳剤を強布する前の各段階におい て適宜行うことができるが、特に別利形成時に添加し、 ハロゲン化銀粉子中に組み込まれることが許ましい。

[0074] これらの化合物をハロゲン化線の拍子形成 中に活加してハロゲン化線矩子中に組み込むたは、金属 解体の物末もしくはNacl, Kclと一緒に溶解した 水溶液を、粒子形成中の水溶性塩または水溶性ハライド 溶液中に添加しておく方法、あるいは鎖塩とルライド溶 液が同時に混合されるとき第3の溶液として添加し、3 液同時高をか方式でハロゲン化線矩子を調整する方法。 あるいは効子形象中に必要単つの最新体の水溶液を反応 容器に投入する方法などである。特に物末もしくはNa Cl, Kclと一緒に溶解した水溶液を、水溶性ハライ 溶液性が振りまる方法が含として 溶液性が振りまる方法が含まる。

【0075】粒子表面に添加するには、粒子形成直後または物理熱成時途中もしくは終了時または化学熱成時に必要量の金属錯体の水溶液を反応容器に投入することも

できる。
「0076] 本表明で用いられるイリジウム化合物としては種々のものを使用できるが、例えばヘキサクロロイリジウム、ペキサウンメイリジウム、ベンタクロロトロジルイリジウム、ペキサンシメイリジウム、ベンタクロロトロシルイリジウム、ペキサンス・イリジウム、ベンタクロロトロシルイリジウムを参加。大きないるでは、イリジウム化合物は、水ちない活産が全球機に高様して用いるが、イリジウム化合物の溶液を安定化させるために一般によく行われる方法、すなわち、ハロゲン化水素水が溶液(例えば低度)、あるいはハルボンベルアルカリ(例えば低で1、NaC1、KBr、NaBr等)を添加する方法を用いることができる。水溶性イリジウムを用いる代かりにハロゲン化機和関呼時に、あらかじめイリジウムを用いる代からにハロゲン化機和関呼時に、あらかじめイリジウムをドーフしてある別のハロゲン化機和アを添加して感染せどるととも可能である。

【0077】さらに本発明に用いられるハロゲン化網粒 子は、コゾルト、鉄、ニッケル、クロム、パラジウム、 白金、金、クリウム、朝、錦、等の金融原子を含有して もよい、コゾルト、鉄、クロム、さらにルテニウムの化 合物についてはブンアノ金配高値を含すとして用いること ができる。具体所としては、フェリシアン酸イオン、フ ェロシアン酸イオン、ヘキサシアノコゾルト酸イオン、フ エロシアン酸イオン、ヘキサシアノカト酸イオン、カ 能イオンなどが挙げるれるが、これらに限定されるもの ではない、ハロゲン化銀中の金属結構は均一に含有させ でもよく、コア部に高速度に含有させてもよく、参るい はシェル都に高速度に含有させてもよく等に刺眼はな いった

【0078】上記金属ハロゲン化銀1モル当たり1×1 0-0~1×10~1モルが好ましい。また、上記金属を含 有させるには単塩、複塩、または結塩の形の金属塩にし て物子੍御興時に添加することができる。

【0079】感光性ハロゲン化銀粒子はヌードル法、フロキュレーション法等。当業界で知られている方法の水 活により脱塩することができるが本発明においては脱塩 してもしなくてもよい。 【008】本発明のハロゲン化銀門剤は化学増感されることが野ましい。化学増添の方法としては、複賞地感 またとが野ましい。化学増添の方法としては、複賞地感 ま、セレン増送法、テルル増添法、貴量風増添洗をの 知られている方法を用いることができ、単独または組み 合わせて用いるれる。組み合わせて使用する場合には、 例なば、複賞機変法との増添法、硫質増添法とかは 感法と金増添法、硫質増添法とテルル増添法と金増添 法、硫質増添法とセレン増添法とデルル増添法と金増添 法、液質増添法とセレン増添法とデルル増添法と金増添

【0081】本発明に用いられる高東推認は、通常、硫 黄地急利を添加して、40℃以上の高温で乳利を一定時 超難件することにより行われる。 新東独感利としては 知の化合物を使用することができ、例えば、ゼラチン中 に含まれる磁硬化合物のほか、種々の耐頭化合物、列え 従子有額線風、チオ原素紙(合物である、頻度地感利の添加 は、化学物成的の日、温度、ハロゲン化線型チの大き さなどの種々の条件下で変化するが、ハロゲン化線1モ ル当たり10⁻¹、10⁻¹ モルであり、より好ましくは1 0⁻¹、10⁻¹ モルであり、より好ましくは1 0⁻¹、10⁻¹ モルであり、より好ましくは1 0⁻¹、10⁻¹ モルであり、より好ましくは1

【0082】本発明に用いられるセレン増整剤としては、分加のセレン化合物を用いることができる。すなわ、適番、不変定型および/よれば外不変差型セレン化合物を添加して40℃以上の高温で引剤を一定時間旋停することにより行われる。不変定型セレン化合物としては特や製料は708条、同63-1389、 機両半4-23855号等に配動の化合物を用いることができる。特が同学+23855号等に配動の化合物を用いることができる。特が同学+23855号等に配動の化合物を用いることができる。特が同学+23855号等に配動の化合物を用いることができる。特に合用サージの表示の一般式(VIII)および(IX)で示される化全物を用いることが

【0083】本発明に用いられるテルル増感剤は、ハロ ゲン化銀粒子表面または内部に、増感核になると推定さ れるテルル化銀を生成させる化合物である。ハロゲン化 銀乳剤中のテルル化銀生成速度については特開平5-3132 84号に記載の方法で試験することができる。テルル増感 剤としては例えばジアシルテルリド類、ビス(オキシカ ルボニル)テルリド類、ピス(カルバモイル)テルリド 類、ジアシルテルリド類、ビス(オキシカルボニル)ジテ ルリド類、ビス(カルバモイル)ジテルリド類、P=Te結合 を有する化合物、テルロカルボン酸塩類、Te-オルガ ニルテルロカルボン酸エステル類。ジ(ポリ)テルリド 類、テルリド類、テルロール類、テルロアセタール類、 テルロスルホナート類、P-Te結合を有する化合物、含T e ヘテロ環類、テルロカルボニル化合物、無機テルル化 合物、コロイド状テルルなどを用いることができる。具 体的には、米国特許第1,623,499号、同第3,320,069号、 同第3,772,031号、英国特許第235,211号、同第1,121,49 6号、同第1,295,462号、同第1,396,696号、カナダ特許 第800,958号、特開平4-204640号、特願平3-53693号、同 【0084】本県明で用いられるセレンおよびゲリルル増 底部の使用量は、使用するハロゲン化銀粒子、化学熱吸 条件等によって変わるが、一般にハロゲン化銀1モル たり10°~10°±ル、発ましくは10°1~10°³モ ル程度を用いる。本発明における代学地感の条件として は特に削削はないが、pHとしては5か68、脚をして は40~95℃、数ましくは40~10℃あり、温度として は40~95℃、数ましくは40~95℃、ある

【0085]本発明で用いられる景金属堪密剤としては、金、白金、パラジウム、イリジウム等が挙げられる 水方 特定金増金がほとい、本発門に用いられる金増盛剤としては具体的には、塩化金酸、カリウムクロロオーレート、カリウムオーリチオシアネート、硫化金などが挙げられ、ハロゲン化銀1モル当たり10-7~10-2モル程度を用いることができる。

【0086】本売明に用いるハロゲン化銀乳剤にはハロゲン化銀乳剤にはハロゲン化銀粒子の形成または物理熱成の透程においてカド マウム塩、亜硫酸塩、鉛塩、クリウム塩などを共存させてもよい。

[0087]本専門においては、選売場場を用いることができる。選売補等法の具体的な化合物としてはアスコルビン酸、三酸化チオ尿素の他に例えば、塩化ポースズ、アミノイミノメケンスルフィン酸、ヒドランと誘導を用いることができる。また、乳剤の利を701上またはかるを3以下に保持して熟成することにより選売機能することができる。また、粒子形成中に集イオンのシングルアディション部分を導入することにより選売機能することとができる。また、粒子形成中に集イオンのシングルアディション部分を導入することにより還元増密することができる。

【0088】本発明のハロゲン化銀乳剤は、欧州公開特 許EP293,917号に示される方法により、チオスルホン酸 化合物を添加してもよい。

[0089]本発明に用いられる熱現像画像形成材料中 のハロゲン化銀乳剤は、一種だけでもよいし、二種以上 (例えば、平均粒子サイズの異なるもの、ハロゲン組成 の異なるもの、品類の異なるもの、化学増聚の条件の異 なるもの) 帰用してもよい。 【0090】本祭卵の変光性ハロケン化像の使用量としては有機機型・モルに対して感光性ハロケン化線の、50年ル以上の5年ル以下が許まして、0.03年ル以上の5年ル以下がかまりました。3年北以上の5年ル以上の5年ル以下がかに対した。3年北以下がかに対した。3年北以下がかに数さまり、3年は一次の一次では、それぞれ演製をプレたハロゲン化線粒子とも機能進を高速撹拌機やボールドル・サンドとル、コロイドミル、カロドンは、カロドのは、カロドンは、カロドは、カロドンは、カロドンは、カロドンは、カロドンは、カロドンは、カロドンは、カロドンは、カロドンは、カロドンは、カロドンは、カロドンは、カロドンは

【0091】本発明のハロゲン化銀調製法としては、有 緩緩塩の一部の銀を有機主たは無機のハロゲン化物でハ ロゲン化するいわゆるハライデーション法も好ましく用 いられる。ここで用いる有機ハロゲン化物としては有機 緩塩と反応しハロゲン化銀を生成する化合物で有ればい かなる物でもよいが、N-ハロゲノイミド(N-ブロモスク シンイミドなど)、ハロゲン化4級窒素化合物(臭化テト ラブチルアンモニウムなど)、ハロゲン化4級窒素塩とハ ロゲン分子の会合体(過車化臭化ビリジニウム)などが挙 げられる。無機ハロゲン化合物としては有機銀塩と反応 しハロゲン化銀を生成する化合物で有ればいかなる物で もよいが、ハロゲン化アルカリ金属またはアンモニウム (塩化ナトリウム、臭化リチウム、沃化カリウム、臭化 アンモニウムなど)、ハロゲン化アルカリ土類金属(臭化 カルシウム、塩化マグネシウムなど) ハロゲン化滞移 金属(塩化第2鉄、単化第2鯡など)、ハロゲン配位子を有 する金属錯体(臭化イリジウム酸ナトリウム、塩化ロジ ウム酸アンモニウムなど)、ハロゲン分子(臭素、塩素、 沃素)などがある。また、所望の有機無機ハロゲン化物 を併用しても良い。

【0092】本発明でハライデーションする際のハロゲン化物の添加量としては有機銀塩にモル当たりハロゲン 原子としてInモルー500mモルが好ましく、10mモルー250 mモルがさらに好ましい。

【0093】本売野に用いることのできる有機機能は、 光性に対して比較的安定であるが、鑑光された光触館、感 光性いロゲン化板の潜像など)および運元列の存在で で、80で成いはそれ以上に加熱された場合に頻画像を形 成する頻繁である。有機機能は増大すどを運元できる を含む任意の有機物質であってよい、有機能の線域、特 に(美業数が10~30、哲ましくは15~28の)長額脂肪カル ポン酸の模型が併えしい。配位子が4,0~10、0つ範囲の 頻安に貯定数を有する有数または無機機度の解析も好ま しい、銀代格物質は、好ましくは四種未成類の影響、か好 に、銀代格物質は、好ましくは四種未成類の影響、 かがまたが、 の機は、新生といす機関幅は ルボギンル基を有する有機化合物の機様を含む。これら の例は、脂肪はかれずと物の機様とび手を体かかポン 酸の銀塩を含むがこれらに限定されることはない。脂肪 族カルポン酸の銀塩の好ましい例としては、ペン酸 銀、アラキジシ酸銀、ステアリン酸銀、オレイン酸銀、 ラウリン酸銀、カブロン酸銀、ミリスチン酸銀、バルミ チン酸銀、マレイン酸銀、フマル酸銀、酒石酸銀、リノ ール酸銀、融酸銀および樟脳酸銀、これらの混合物など 含含む。

【0094】メルカプト基またはチオン基を含む化合物 の銀塩およびこれらの誘導体を使用することもできる。 これらの化合物の好ましい例としては、3-メルカプト-4 フェニル-1,2,4-トリアゾールの銀塩、2-メルカプトベ ンズイミダゾールの銀塩、2-メルカプト-5-アミノチア ジアゾールの銀塩、2-(エチルグリコールアミド)ベン ゾチアゾールの銀塩、S-アルキルチオグリコール酸(こ こでアルキル基の炭素数は12~22である)の銀塩などの チオグリコール酸の銀塩、ジチオ酢酸の銀塩などのジチ オカルボン酸の銀塩、チオアミドの銀塩、5-カルボキシ ルー1-メチルー2-フェニルー4-チオピリジンの銀塩、メル カプトトリアジンの銀塩、2-メルカプトベンズオキサゾ ールの銀塩、米国特許第4,123,274号に記載の銀塩、例 えば3-アミノ-5-ベンジルチオ-1,2,4-チアゾールの銀塩 などの1.2.4-メルカプトチアゾール誘導体の銀塩、米国 特許第3,301,678号に記載の3-(3-カルボキシエチル)-4-メチル-4-チアゾリン-2-チオンの銀塩などのチオン化合 物の銀塩を含む。さらに、イミノ基を含む化合物も使用 することができる。これらの化合物の好ましい例として は、ベンゾトリアゾールの銀塩およびそれらの誘導体、 例えばメチルベンゾトリアゾール銀などのベンゾトリア ゾールの銀塩、5-クロロベンゾトリアゾール銀などのハ ロゲン置換ベンゾトリアゾールの銀塩、米国特許第4.22 0,709号に記載のような1,2,4-トリアゾールまたは1-H-テトラゾールの銀塩、イミダゾールおよびイミダゾール 誘導体の銀塩などを含む。例えば、米国特許第4,761,36 1号および同第4,775,613号に記載のような種々の銀アセ チリド化合物をも使用することもできる。

[0095]本発明に用いることができる有機機成の形状としては特に制限はないが、短輪と異軸を有する針状 統治では大きい、未発明においては短輪のの1ヵ以上の、20ヵ以下が発ましく、短輪の01ヵ以上の、15ヵ以上5.0ヵ以下が発ましく、短輪の01ヵ以上0.15ヵ以下、長輪0.10ヵ以上6.0ヵ以下がより容ましい。有機線域の配子ウイス分布は中分散であることが好ましい。半分散とは短線、長輪を孔ぞれの長さらば半頃をと短線、長輪を孔ぞれの長さらば半頃をと短線、長等紀れで中別で値の百分を分野ましくは50以下である。有機線返の形状の測定方法としては有機地域が開かる法型でする別の方法として、有機地域の体情が重率が直径の様準保護を求める方法があり、体税加重平均直径の様準保護を求める方法があり、体税加重平均直径の様準保護を求める方法があり、体税加重平均直径で様常を対象につきずに変め、

更に好ましくは50%以下である。測定方法としては例え ば液中に分散した有機製塩にレーザー光を照射し、その 散乱光のゆらぎの時間変化に対する自己相関関数を求め ることにより得られた粒子サイズ(体積加重平均直径)か ら求めることができる。

【0006】木売門に用いることのできる有機銀缸と 貯ましくは脱塩をすることができる。 脱塩を行う方法と しては特に制限はなく公知の方法を用いることができる が、遠心が過、吸引が過、複禁法によるフロ ック解放水洗海の公知のが追方法を好ましく用いること ができる。

[0097]本列明に用いることのできる有機機能は粒 オサイズの小さい、凝集のない微粒子を得る目的で、分 液剤を使用した部体域粒子分散が物とする方法が用いられ る。積機類な医部域粒子分散化する方法は、分散助剤 動ボールミル、進黒ボールミル、サンドミル、 ミル・ジェットミル、ローラーミル、高圧ホモジオイザ 一)を用い、機能的に分散することができる。

【0098】有機銀塩を分散剤を使用して固体微粒子化 する際には、例えば、ポリアクリル酸、アクリル酸の共 重合体、マレイン酸共重合体、マレイン酸モノエステル 共重合体、アクリロイルメチルプロバンスルホン酸共重 合体、などの合成アニオンポリマー、カルボキシメチル デンプン、カルボキシメチルセルロースなどの半合成ア ニオンポリマー、アルギン酸、ペクチン酸などのアニオ ン性ポリマー、特開昭52-92716号、W088/04794号など に記載のアニオン性界面活性剤、特願平7-350753号に記 戦の化合物、あるいは公知のアニオン性、ノニオン性、 カチオン性界面活性剤や、その他ポリビニルアルコー ル、ポリビニルピロリドン、カルボキシメチルセルロー ス、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピ ルメチルセルロース等の公知のポリマー、或いはゼラチ ン等の自然界に存在する高分子化合物を適宜選択して用 いることができる。

【0099】/散弦刺は、分散前に有機線塩の粉末またはウェットケーキ状態の有機銀塩と混合し、スラリーと介放機に送り込むのは一般的な方法であるが、子め有機銀塩と混ぜ合わせた状態で熱処理や溶媒による処理を施して有機線塩と混ぜ合わせた状態で熱処理や溶媒による処理を施して有機線塩と混せ合かは分散中に適当な州調整剤によりpHコシトロールしても良い。

【0100】機械的に分散する以外にも、pflコントロー ルすることで溶媒中に租分散し、その後、分散助利の存 を下でPBを変化させて微粒子化させても良い。このと き、現分散に用いる溶媒として有機溶媒を使用しても良

さ、祖介畝に用いる溶媒として有機溶媒を使用しく、通常有機溶媒は微粒子化終了後除去される。

【0101】調製された分散物は、保存時の微粒子の沈 降を抑える目的で撹拌しながら保存したり、親水性コロ イドにより粘性の高い状態(例えば、ゼラチンを使用し ゼリー状にした状態)で保存したりすることもできる。 また、保存時の雑菌などの繁殖を防止する目的で防腐剤 を添加することもできる。

【0102】本発明の有機銀塩は所望の量で使用できるが、無球像画像配録材料1㎡当たりの量で示して、銀畳として0.1~58/㎡が好ましく、さらに好ましくは1~38/㎡である。

【0103】本売明の熱現職兩像記録材料には右機銀塩のための適元利金を含むことが打ましい。有機販販のための適元利金を対したいました。 日本の金元利金を担いるできない。 フェニドン、ハイドロキノンおよびカテコールなどの従来の写真現像剤は有用であるが、ヒンダードフェノール電元剤が君ましい。 還元剤は、画像形成屋をすする面の娘に中に対して5~50~(モル)を含むることが苦ましい。 遠元剤の添加層は画像形成屋を有する面のかなる層でも良い。 直筋形成層は画像形成屋を有する面のかなる層でも良い。 直筋形成所はいい。 日本の後に大学といりで含まれることがきるに対ましい。 遠元剤の添加層は画像形成房を有する面のいかなる層でも良い。 遠元剤の添加層は画像形成の尾を有する面のいかなる層でも良い。 遠元剤の添加層は画像形成の尾を有する面のいかなる層でも良い。 また。 還元剤は現場の内容が、原性でありまり、また。 還元剤は現場の名前が、開発を持つようには薄化されていわゆるアレカーサーであってもよい。

【0104】有機銀塩を利用した熱現像感光材料におい ては広範囲の還元剤が特開昭46-6074号、同47-1238号、 同47-33621号。同49-46427号。同49-115540号。同50-14 334号、同50-36110号、同50-147711号、同51-32632号、 同51-1023721号。同51-32324号。同51-51933号。同52-8 4727号、同55-108654号、同56-146133号、同57-82828 号 同57-82829号 特開平6-3793号 米国特許3,667,95 86号、同3,679,426号、同3,751,252号、同3,751,255 号、同3,761,270号、同3,782,949号、同3,839,048号、 **同3.928.686号**。同5.464.738号。独国特許2321328号。 欧州特許692732号などに開示されている。例えば、フェ ニルアミドオキシム、2-チエニルアミドオキシムおよび p-フェノキシフェニルアミドオキシムなどのアミドオキ シム:例えば4-ヒドロキシ-3.5-ジメトキシベンズアル デヒドアジンなどのアジン: 2.2-ビス(ヒドロキシメチ ル)プロピオニル-β-フェニルヒドラジンとアスコルビ ン酸との組合せのような脂肪族カルボン酸アリールヒド ラジドとアスコルビン酸との組合せ:ポリヒドロキシベ ンゼンと、ヒドロキシルアミン、レダクトンおよび/ま たはヒドラジンの組合せ(例えばハイドロキノンと、ビ ス(エトキシエチル)ヒドロキシルアミン、ピペリジノへ キソースレダクトンまたはホルミル-4メチルフェニル ヒドラジンの組合せなど):フェニルヒドロキサム酸。p - L ドロキシフェニルL ドロキサム酸および R-アリニン ヒドロキサム酸などのヒドロキサム酸: アジンとスルホ ンアミドフェノールとの組合せ(例えば、フェノチアジ ンと2.6-ジクロロ-4-ベンゼンスルホンアミドフェノー ルなど);エチル-α-シアノ-2-メチルフェニルアセテー ト、エチル-α-シアノフェニルアセテートなどのα-シ

アノフェニル酢酸添漢体: 2,2-ジヒドロキシ-1,1-ビナ フチル、6.6-ジプロモ-2.2-ジヒドロキシ-1.1-ビナフチ ルおよびビス(2-ヒドロキシ-1-ナフチル)メタンに例示 **されるようなビス-β-ナフトール**: ビス-β-ナフトール と1.3-ジヒドロキシベンゼン誘導体(例えば、2.4-ジヒ ドロキシベンゾフェノンまたは2,4-ジヒドロキシアセト フェノンなど)の舞合せ:3-メチル-1-フェニル-5-ピラ ゾロンなどの、5-ピラゾロン;ジメチルアミノヘキソー スレダクトン、アンヒドロジヒドロアミノヘキソースレ ダクトンおよびアンヒドロジヒドロピペリドンヘキソー スレダクトンに例示されるようなレダクトン:2.6-ジク ロロ-4-ベンゼンスルホンアミドフェノールおよびp-ベ ンゼンスルホンアミドフェノールなどのスルホンアミド フェノール還元剤: 2-フェニルインダン-1.3-ジオンな ど: 2.2-ジメチル-7-t-ブチル-6-ヒドロキシクロマン などのクロマン; 2,6-ジメトキシ-3,5-ジカルボエトキ シ-1.4-ジヒドロビリジンなどの1.4-ジヒドロビリジ ン; ビスフェノール(例えば、ビス(2-とドロキシ-3-t-ブチルー5-メチルフェニル)メタン、2.2-ビス(4-ヒドロ キシ-3-メチルフェニル)プロパン、4.4-エチリデン-ビ ス(2-t-ブチル-6-メチルフェノール) . 1.1-ビス(2-と ドロキシ-3.5-ジメチルフェニル)-3.5.5-トリメチルへ キサンおよび2,2-ビス(3,5-ジメチル-4-ヒドロキシフェ ニル)プロパンなど): アスコルビン酸誘導体(例えば、 パルミチン酸1-アスコルビル、ステアリン酸アスコルビ ルなど);ならびにベンジルおよびビアセチルなどのア ルデヒドおよびケトン: 3-ピラゾリドンおよびある種の インダン-1.3-ジオン:クロマノール(トコフェロールな ど)などがある。特に好ましい選元剤としては、ビスフ ェノール、クロマノールである。

[0105]本発明の選売剤は、溶液、粉末、固体微粒 子分散物などいかなる方法で源がしてもよい。固体微粒 子分散しな分の放射化手段の気は、ボールシル、頻動 ボールミル、サンドミル、コロイドミル、ジェットミ ル、ローラーミルなど)で行われる。また、固体微粒子 分散する際と分散的多年リンでもよい。

【0106】画祭を向上させる「色識剤」として知られる流加剤を含むと光学濃度が高くなることがある。また、色調剤は温色螺菌像を形成させるうえでも有利になることがある。色調剤は画像形成層を有する面に銀1モル当たりの0.1-5以(モル)の豊をまれることが好ませ、いまた、色調剤は現像時のみ有効に機能を持つように誘導化されたいよかるアレカーサーであってもよい。 【0107】看線螺旋を利用した勢望後感光性材によい

ては広範囲の色融別が特勢開発-6077等、同47-10282 号、同49-5019号、同49-5020号、同49-91215号、同49-9 1215号、同59-2524号、同50-32827号、同50-67132号。 同50-67641号、同50-114217号、同51-3223号、同51-279 23号、同52-14788号、同52-99813号、同53-1020号、同5

3-76020号、同54-156524号、同54-156525号、同61-1836 42号、特開平4-56848号、特公昭49-10727号、同54-2033 3号、米国特許3,080,254号、同3,446,648号、同3,782,9 41号、同4,123,282号、同4,510,236号、英国特許138079 5号、ベルギー特許841910号などに開示されている。色 調剤の例は、フタルイミドおよびN-ヒドロキシフタルイ ミド:スクシンイミド、ピラゾリン-5-オン、ならびに キナゾリノン、3-フェニル-2-ピラゾリン-5-オン、1-フ ェニルウラゾール、キナゾリンおよび2.4-チアゾリジン ジオンのような環状イミド: ナフタルイミド(例えば、N -ヒドロキシ-1,8-ナフタルイミド);コバルト錯体(例え ば、コバルトヘキサミントリフルオロアセテート):3-メルカプト-1,2,4-トリアゾール、2,4-ジメルカプトピ リミジン、3-メルカプト-4.5-ジフェニル-1,2,4-トリア ゾールおよび2.5-ジメルカプト-1.3.4-チアジアゾール に例示されるメルカプタン: N-(アミノメチル)アリール ジカルボキシイミド、(例えば、(N,N-ジメチルアミノメ チル)フタルイミドおよびN,N-(ジメチルアミノメチル)-ナフタレン-2.3-ジカルボキシイミド): ならびにブロッ ク化ピラゾール、イソチウロニウム誘導体およびある種 の光浪色割(例えば、N.N'-ヘキサメチレンビス(1-カル バモイル-3.5-ジメチルピラゾール)、1.8-(3.6-ジアザ オクタン)ビス(イソチウロニウムトリフルオロアセテー ト)および2-トリプロモメチルスルホニル)-(ベンゾチア ゾール)): ならびに3-エチル-5[(3-エチル-2-ベンゾチ アゾリニリデン)-1-メチルエチリデン1-2-チオ-2.4-オ キサゾリジンジオン: フタラジノン、フタラジノン誘導 体もしくは金属塩、または4-(1-ナフチル)フタラジノ ン、6-クロロフタラジノン、5.7-ジメトキシフタラジノ ンおよび2,3-ジヒドロ-1,4-フタラジンジオンなどの誘 導体:フタラジノンとフタル酸誘導体(例えば、フタル 酸、4-メチルフタル酸、4-ニトロフタル酸およびテトラ クロロ無水フタル酸など)との組合せ:フタラジン、フ タラジン誘導体もしくは金属塩、または4-(1-ナフチル) フタラジン、6-クロロフタラジン、5.7-ジメトキシフタ ラジンおよび2,3-ジヒドロフタラジンなどの誘導体;フ タラジンとフタル酸誘導体(例えば、フタル酸、4-メチ ルフタル酸、4-二トロフタル酸およびテトラクロロ無水

【01121一級式(1)においてR1、R2、R2は、それそれ独立に水栗原子または電乗機差を表し、乙は電子機 別性基まだはシリル基を表す、一般式(1)においてR1 とZ、R1とR2、R1とR2、あるいはR2とZは、互い に結合して環状構造を形成していてもよい、一般式(2) においてPはは、階級基を表す。一般式(3)において フタル酸など)との組合せ;キナゾリンジオン、ベンズ オキサジンまたはナフトオキサジン誘導体: 色調調節剤 としてだけでなくその場でハロゲン化銀生成のためのハ ライドイオンの源としても機能するロジウム錯体、例え ばヘキサクロロロジウム(III)酸アンモニウム、臭化ロ ジウム、硝酸ロジウムおよびヘキサクロロロジウム(II I)酸カリウムなど:無機過酸化物および過硫酸塩、例え ば、過酸化二硫化アンモニウムおよび過酸化水素: 1.3-ベンズオキサジン-2.4-ジオン、8-メチル-1.3-ベンズ オキサジン-2.4-ジオンおよび6-ニトロ-1.3-ベンズオキ サジン-2,4-ジオンなどのベンズオキサジン-2,4-ジオ ン: ピリミジンおよび不斉-トリアジン(例えば、2.4-ジ ヒドロキシピリミジン、2-ヒドロキシ-4-アミノピリミ ジンなど)、アザウラシル、およびテトラアザペンタレ ン誘連体(例えば、3.6-ジメルカプト-1.4-ジフェニル-1 II. 4II-2.3a, 5.6a-テトラアザペンタレン、および1.4-ジ (o-クロロフェニル)-3,6-ジメルカプト-1H,4H-2,3a,5,6 a-テトラアザペンタレン)などがある。

[0108]本発野の色調剤は、溶液、粉末、固体検粒 子分散物などいかなる方法で活加してもよい。固体検粒 子分散は全外の解離化手段(例は、ボールミル、推動 ボールミル、サンドミル、コロイドミル、ジェットミ ル、ローラーミルなど)で行われる。また、固体微壮子 分散する際に分散効剤を用いてもよい。

[0109] 木奈県の詹珉県衛富証参が料は、暖脚之面 億を得るために、好きしくは面像形成層および/または その隣集層中に癌短頭化剤と合有する。本発明に用いら れる短距側化剤としては、一般式(1)で表される電換 アルケン誘導体、一般式(2)で表される前換イソネキ サブール移跡体、一般式(3)で表される前使のアセク ール化金物、およびヒドラジン誘導体が完ましく用いら ある。

【0110】本発明で用いられる一般式(1)で表される置換アルケン誘導体、一般式(2)で表される置換イソオキサゾール誘導体、および一般式(3)で表される 特定のアセタール化合物について説明する。

【0111】 【化2】

X、Yはそれぞ於頼立に水変順子または直接達を表し、 A、Bはそれぞ於頼立に、アルコキシ基、アルキルチオ 基、アルキルアミノ基、アリールオキシ基、アリールチ オ基、アニリノ基、ヘテロ環オキシ基、ヘテロ環チオ 基、またはヘテロ環アミノ基を表す。一般式(3)におい てXとY、あない社AとBは、互いに結合して顕微精造 を形成していてもよい。

【0113】一般式(1)で表される化合物について詳しく説明する。

【0114】一般式(1)においてR¹、R²、R²は、それぞれ独立に水栗原子または画換基を表し、乙は電子破刊性基またはシリル基を表す。一般式(1)においてR¹とZ²、R²とR²、R²とR³、R²とR³、なるいはR²と乙は、互いに結合して環状構造を形成していても良い。

【0115】R1、R2、R3が置換基を表す時、置換基 の例としては、例えばハロゲン原子(フッ素原子、クロ ル原子、臭素原子、または沃素原子)、アルキル基(ア ラルキル基、シクロアルキル基、活性メチン基等を含 む)、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、ヘテ ロ環基(N-置換の含窒素ヘテロ環基を含む)、4級化 された窒素原子を含むヘテロ環基(例えばピリジニオ 基)、アシル基、アルコキシカルボニル基、アリールオ キシカルボニル基、カルバモイル基、カルボキシ基また はその塩、イミノ基、N原子で置換したイミノ基、チオ カルボニル基、スルホニルカルバモイル基、アシルカル バモイル基、スルファモイルカルバモイル基、カルバゾ イル基、オキサリル基、オキサモイル基、シアノ基、チ オカルバモイル基、ヒドロキシ基またはその塩、アルコ キシ基(エチレンオキシ基もしくはプロピレンオキシ基 単位を繰り返し含む基を含む)、アリールオキシ基、ヘ テロ環オキシ基、アシルオキシ基、(アルコキシもしく はアリールオキシ) カルボニルオキシ基、カルバモイル オキシ基、スルホニルオキシ基、アミノ基、(アルキ ル, アリール, またはヘテロ環) アミノ基、アシルアミ ノ蒸、スルホンアミド蒸、ウレイド蒸、チオウレイド 基、イミド基、(アルコキシもしくはアリールオキシ) カルボニルアミノ基、スルファモイルアミノ基、セミカ ルバジド基、チオセミカルバジド基、ヒドラジノ基、4 級のアンモニオ基、オキサモイルアミノ基、(アルキル もしくはアリール) スルホニルウレイド基、アシルウレ イド基、アシルスルファモイルアミノ基、ニトロ基、メ ルカプト基、(アルキル、アリール、またはヘテロ環) チオ基、アシルチオ基、(アルキルまたはアリール)ス ルホニル基、(アルキルまたはアリール)スルフィニル 基、スルホ基またはその塩、スルファモイル基、アシル スルファモイル基、スルホニルスルファモイル基または その塩、ホスホリル基、リン酸アミドもしくはリン酸エ ステル構造を含む基。シリル基、スタニル基等が挙げら れる。

【0116】これら置換基は、これら置換基でさらに置 扱されていてもよい。

[0117] 一般式(1)において2で表される電子吸引 性差とは、ハメットの置換差主数のロが正の値を取りう る置換差のことであり、具体的には、シアノ基、アルコ キシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カル バモイル基、イミノ基、N原子で置換したイミノ基、ナ オカルボニル基、スルファモイル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、ニトロ第、のロゲン原 デ、パーフルイフルトは悪、ドーフルスーアルカンア ミド基、スルホンアミド基、アシル基、ホルミル基、ホ スホポル基、カルボキン基(またはその塩)、スルボ基 (またはその塩)、ヘテロ環産、アルケコル基、アルテンル基、アシルクオき)基、アシルオオシ基、アルナオ差、スルホニルオ キシ基、またはこれら電子吸引作素で置換されたアリー ル基等である。ここにヘテロ環塞としては、熱和もしく は不験和のヘテロ環塞・関えばビリジル基、キノリル 基、ビジニルを集、キノキャリール基、ベンパリル基、キグリル 基、ビジニルを集、キノキャリル、基、ベンツイリル番、トグリル 、イミダソリル番、スクシンイミド第、フタルイミ ド港等がその関しに実がそれた。

[0118] 一駅次(1)において又で表される電子吸引 性素は、さらに電波差を占していてもよく、その電換差 としては、一様式(1)のR!、R!、R!が煙糖臭を表す 時に有していてもよい電振動と同じものが挙げられる。 [0119] 一般式(1)においてR!とZ、R!とR! R!とR!、あるいはR!とZに、互いに結合して環状構造 造を形成していてもよいが、この時形成される環状構造 とは、非芳香族の炭素環もしくは非芳香族のヘテロ環で ある。

【0120】次に一般式(1)で表される化合物の好まし い範囲について述べる。

【0121】一般式(1)において2で表されるシリル基 として哲主しくは、具体的にトリメチルシリル基、セー プチルジメチルシリル蓋、フェニルジメチルシリル基、ト トリエチルシリル為、トリイソプロビルシリルあ、トリ メチルシリルジメチルシリル 蓋等である。

【0122】一般式(1)においてZで表される電子吸引 性基として好ましくは、総炭素数0~30の以下の基。 即ち、シアノ基、アルコキシカルボニル基、アリールオ キシカルボニル基、カルバモイル基、チオカルボニル 基、イミノ基、N原子で置換したイミノ基、スルファモ イル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル 基、ニトロ基、パーフルオロアルキル基、アシル基、ホ ルミル基、ホスホリル基、アシルオキシ基、アシルチオ 基、または任意の電子吸引性基で置換されたフェニル基 等であり、さらに好ましくは、シアノ基、アルコキシカ ルボニル基、カルバモイル基、イミノ基、スルファモイ ル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、 アシル基、ホルミル基、ホスホリル基、トリフルオロメ チル基、または任意の電子吸引性基で置換されたフェニ ル基等であり、特に好ましくはシアノ基、ホルミル基、 アシル基、アルコキシカルボニル基、イミノ基またはカ ルバモイル基である。

【0123】一般式(1)においてZで表される基は、電子吸引性基がより好ましい。

【0124】一般式(1)においてR1, R2, およびR3

で表される置機をして好ましくは、程度素数の-30 の基で、具体的には上述の一般式(1)のので表される電 毎別行鑑を回職の温、およびアルやル基、ヒドロキシ 邁(またはその娘)、メルカアト高(またはその娘)、アル コキシ基、アリールオキシ基、ヘテロ環ケン基、アル キルチオ基、アリールチオ基、ヘテロ環ケオ基、アミノ 基、アルキルアミン基、アリールアミン基、ヘプロ環ア ミノ基、ウレイド基、アシルアミン基、スルホンアミド 基、または置換もしくは無重複のアリール基等が挙げら りた。

【0125】さらに一般式(1)において R'は、好まし くは電子吸引性差、アリール差、アルキルチオ差、アル コキシ差、アシルアミノ蒸、水素原子またはシリル基で ある。

【0126】P1が電子吸引性基を表す時 好ましくは 総炭素数0~30の以下の基、即ち、シアノ基、ニトロ 基、アシル基、ホルミル基、アルコキシカルボニル基、 アリールオキシカルボニル基、チオカルボニル基、イミ ノ基、N原子で置換したイミノ基、アルキルスルホニル 基、アリールスルホニル基、カルバモイル基、スルファ モイル基、トリフルオロメチル基、ホスホリル基、カル ボキシ基(またはその場)。または飽和もしくは不飽和 のヘテロ環基であり、さらにシアノ基、アシル基、ホル ミル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、イ ミノ基、N原子で関換したイミノ基、スルファモイル 基、カルボキシ基(またはその塩)、または飽和もしく は不飽和のヘテロ環基が好ましい。特に好ましくはシア ノ基 ホルミル基 アシル基 アルコキシカルボニル 基、カルバモイル基、または飽和もしくは不飽和のヘテ ロ琛基である。

【0127】R:がアリール基を表す時、好ましくは総 炭素数6~30の、置換もしくは無電換のフェニル基で あり、置換基としては、任態の置換基が挙げられるが、 中でも電子吸引性の置換基が好ましい。

【0128】一果式(1)においてPIは、より剪ましくは、電子吸引性差またはアリール法を表す時である。 (0129) 一飛代(1)においてPIさまび下で換される置換として貯すましくは、具体的に、上述の一根式 (1)の乙で設される電子吸引性基と同義の基、アルキル基、トトロキン基(ほたはその個、メルカアト基(はた はその個、アルコキン基、アリールオキン基、ペテロ 環オキン基、アルキルチオ島、アリールチオ島、ペテロ 環オキン基、アルキルチオ島、アリールチオ島、ペテロ 環ケオ島、アミノ基、アルデミノ基、産場もしくは無選 機のフェニル基等である。

【0130】一般式(1)においてR*およびR*は、さら に好ましくは、どちらか一方が水栗原子で、他方が環境 基を表す時である。その置換差しと好ましくは、アル キル基、ヒドロキシ基(またはその塩)、メルカプト基 (またはその塩)、アルコキシ基、アリールオキシ基、へ テロ環オキン基、アルキルナオ基、アリールチオ基、ヘ テロ環オオ基、アミノ基、アルキルアミノ基、アニリノ 素、ヘテロ環アミノ基、アシルアミノ基(特にケーフル オロアルカンアミド基)、スルホンアミド基、置換もし くは無重限のフェニル基、またはヘテロ環基等であり、 さらに対すしくはじドロキン基(またはその塩)、メルカ アト基は大はその塩)、アルコキシ基、ペラロ環オタ基、ハテロ環チャス基、ストルナオ基、アルールオタ 基、ヘラロ環オオ基、またはヘテロ環基であり、特に好ましくはヒドロキシ基(またはその塩)、アルコキシ基、たまたはヘテロ環基であり、デルコキシ基、またはイテロ環基であり、デルコキシ基、またはインテロ環基である。

(0131] 一般式(1)において2と記り、あるいはまた記とかいまた記とか野犬精造を形成する場合はまだ針とし、この場合に対象される環状構造は、非芳香族の火茶環もしくは非芳奈族のヘアロ環であり、探ましくほう真~7月の環状構造で、置換基を含めたその総炭茶数は1~40、さらにはよ~30が好ましい。

【0132】一般式(1)で表される化合物の中で、より 好ましいものの1つは、Zがシアノ基、ホルミル基、ア シル基、アルコキシカルボニル基、イミノ基、またはカ ルバモイル基を表し、R1が電子吸引性基またはアリー ル基を表し、R2またはR3のどちらか一方が水素原子 で、他方がヒドロキシ基(またはその塩)、メルカプト基 (またはその塩)、アルコキシ基、アリールオキシ基、ヘ テロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、ヘ テロ環チオ基、またはヘテロ環基を表す化合物である。 さらにまた一般式(1)で表される化合物の中で特に好ま しいものの1つは、ZとR1とが非芳香族の5日~7日 の環状構造を形成していて、R2またはR3のどちらか一 方が水素原子で、他方がヒドロキシ基(またはその塩)、 メルカプト基(またはその塩)、アルコキシ基、アリール オキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリー ルチオ基、ヘテロ環チオ基、またはヘテロ環塞を表す化 合物である。この時、R1と共に非芳香族の環状構造を 形成する乙としては、アシル基、カルバモイル基、オキ シカルボニル基、チオカルボニル基、スルホニル基等が 好ましく、またR1としては、アシル基、カルバモイル 基、オキシカルボニル基、チオカルボニル基、スルホニ ル基、イミノ基、N原子で置換したイミノ基、アシルア ミノ基、カルボニルチオ基等が好ましい。

【0133】次に一般式(2)で表される化合物について 説明する。

【0134】一般式(2)においてR*は置換基を表す。 R*で表される置換基としては、一般式(1)のR*へR* の置換基について説明したものと同じものが挙げられ 2

【0135】R*で表される置換蒸は、好ましくは電子 吸引性差またはアリール差である。R*が電子吸引性差 を表す時、好ましくは、総炭素数0~30の以下の基、 即ち、シアノ基、二トロ基、アシル基、ホルミル基、ア ルコキンカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、カルオ それル差、スルファモイル基、トリアルオロメチル基、ホスホリル基、イミノ基、または飽和らしくは不飽和のヘテロ鑑子であり、さらにシアノ基、アシル基、ホルミル基、アルマキイル基、スルファモイル基、アルトルスルホール基、アルマルをは、アレコキシカルボニル基、カルバモイル基、まなはヘテロ環番が得ましい。特に好ましくはシアノ基、ホルミル基、アンル基、アンル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、まなはヘテロ環番が含る。

【0136】R*がアリール基を表す時、好ましくは総 炭素数0~30の、置換もしくは無置換のフェニル基で あり、置換差としては、一般式(1)のR¹、R²、R²が 置換基を表す時にその置換蓋として説明したものと同じ ものが挙げられる。

[0137] R*は、特に好ましくはシアノ基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基、ヘテロ環基、または置換もしくは無置換のフェニル基であり、最も好ましくはシアノ基、ヘテロ環基、またはアルコキシカルボニル基である。

【0138】次に一般式(3)で表される化合物について 詳しく説明する。

[0199] 一級式(3)においてX、Yはそれぞれ独立 に水栗原子または遺焼基を表し、A、Bはそれぞれ独立 に、アルコキシ基、アルキルチオ基、アルールナイ 基、アリールオキン基、アリールチオ基、アニリノ基 ペテロ房ナオ基、ペテロ環オキシ基、またはペテロ環ア と選を表す、XとY、あるいはAとBは、互いに結合 して環状機能を形成していてもよい。

【0140】 一般式(3)においてX、Yで表される置換 基としては、一般式(1)の $R^1 \sim R^2$ の置換基について説 明したものと同じものが挙げられる。具体的には、アル キル基(パーフルオロアルキル基、トリクロロメチル基 等を含む)、アリール基、ヘテロ環基、ハロゲン原子、 シアノ基、ニトロ基、アルケニル基、アルキニル基、ア シル基、ホルミル基、アルコキシカルポニル基、アリー ルオキシカルボニル基、イミノ基、N原子で置換したイ ミノ基、カルバモイル基、チオカルボニル基、アシルオ キシ基、アシルチオ基、アシルアミノ基、アルキルスル ホニル基、アリールスルホニル基、スルファモイル基、 ホスホリル基、カルボキシ基(またはその塩)、スルホ 基(またはその塩)、ヒドロキシ基(またはその塩)、 メルカプト基(またはその塩)、アルコキシ基、アリー ルオキシ基、ヘテロ環オキシ基、アルキルチオ基、アリ ールチオ基、ヘテロ環チオ基、アミノ基、アルキルアミ ノ基、アニリノ基、ヘテロ環アミノ基、シリル基等が挙 げられる.

【0141】これらの基はさらに置換基を有していても よい。またXとYは、互いに結合して環状構造を形成し ていてもよく、この場合に形成される環状構造として は、非芳香族の炭素環でも、非芳香族のヘテロ環であっ てもよい。

【0142】一般気(3)においてX、Yで表される置線 器は、新ましくは総鉄素数1~40の、より好ましくは 総鉄薬数1~30の基であり、シアノ基、アルンキシカ ルボニル基、アリールオキシカルボニル基、カルバモイ ル基、イシス基、N原子で置娘したイミノ基、チオカル ボニル基、スルファモイル基、アルやルスルホニル基、ア アリールスルホニル基、エトロ基、バーフルオロアルト ル基、アシルオキシ基、ホルミル基、エスホリル基、アント ミノ基、アシルオキシ基、ステルア・コンキア デルキルチオ基、アルコキシ基、またはアリール基等が 挙げられる。

【0143】一般式(3)においてX、Yは、より好まし くはシアノ基 ニトロ基 アルコキシカルボニル基 カ ルバモイル基、アシル基、ホルミル基、アシルチオ基、 アシルアミノ基、チオカルボニル基、スルファモイル 基、アルキルスルホニル基、アリールスルホニル基、イ ミノ基、N原子で置換したイミノ基、ホスホリル基、ト リフルオロメチル基、ヘテロ環基、または置換されたフ ェニル基等であり、特に好ましくはシアノ基、アルコキ シカルボニル基、カルバモイル基、アルキルスルホニル 基、アリールスルホニル基、アシル基、アシルチオ基、 アシルアミノ基、チオカルボニル基、ホルミル基、イミ ノ基、N原子で置換したイミノ基、ヘテロ環基、または 任意の電子吸引性基で置換されたフェニル基等である。 【0144】XとYが、互いに結合して非芳香族の炭素 理。または非芳香炸のヘテロ環を形成している場合もま た好ましい。この時、形成される環状構造は5員~7員 環が好ましく、その総炭素数は1~40、さらには3~ 30が好ましい。環状構造を形成するXおよびYとして は、アシル基、カルバモイル基、オキシカルボニル基、 チオカルボニル基、スルホニル基、イミノ基、N原子で 置換したイミノ基、アシルアミノ基、カルボニルチオ基 等が好ましい。

【0145】一般末(3)においてA、Bはそれぞれ独立 に、アルコキン基、アルキルチオ基、アルキルアナン 基、アリールオキン基、アリールチオ基、エコリノ基、 ペテロ環チオ基、ペテロ環オキン基、またはペテロ環ア ミノ基を表し、これらは互いに結合して環状構造を形成 していてもよい。一般式(3)においてA、Bで表される 基は、好ましくは総炭素数1~40の、より好ましくは 総炭素数1~30の基であり、さらに置換基を有してい でもよい。

【0146】 - 駅式(3)においてA、Bは、これらが互 いに結合して環状構造を形成している場合がより好まし い、この時形度される環状構造は5員~7 貝環の非芳香 歳のペテロ環が好ましく、その総炭素数は1~40、さ らには3~30が好ましい。この場合に、A、Bが連結 した例(-A-B-)を挙抒れば、例えば-O-(C $\begin{array}{l} H_2)_2 - O -, & -O - \left(CH_1 \right)_3 - O -, & -S - \left(CH_2 \right)_3 - S -, & -S - \left(CH_3 \right)_3 - S -, & -S - ph - S \\ -, & -N \left(CH_2 \right) - \left(CH_2 \right)_2 - O -, & -N \left(CH_3 \right) \\ - \left(CH_2 \right)_2 - S -, & -O - \left(CH_2 \right)_4 - S -, & -O - \left(CH_3 \right)_3 - S -, & -N \left(CH_3 \right) - ph - O -, & -N \\ - \left(CH_3 \right)_3 - S -, & -N \left(CH_3 \right) - ph - O -, & -N \\ - \left(CH_2 \right)_3 - S -, & -N \left(CH_3 \right) - \left(CH_2 \right)_2 - S - \% ch_2 \end{array}$

【0147】本発明の一般式(1)~一般式(3)で表され

る化合物は、ハロゲン化銀に対して吸着する吸着性の基 が組み込まれていてもよい。こうした吸着熱としては、 アルキルチオ基、アリールチオ基、チオ尿素基、チオア ミド基、メルカプト複素環基、トリアゾール基などの米 国特許第4、385、108号、同4、459、347 号、特開昭59-195233号、同59-20023 1号、同59-201045号、同59-201046 号、同59-201047号、同59-201048 号、同59-201049号、特開昭61-17073 3号、同61-270744号、同62-948号、同 63-234244号、同63-234245号、同6 3-234246号に記載された基が挙げられる。また これらハロゲン化銀への吸着基は、プレカーサー化され ていてもよい。その様なプレカーサーとしては、特開平 2-285344号に記載された基が挙げられる。 【0148】本発明の一般式(1)~一般式(3)で表され る化合物は、その中にカプラー等の不動性写真用添加剤 において常用されているバラスト基またはポリマーが組 み込まれているものでもよい。特にバラスト基が組み込 まれているものは本発明の好ましい例の1つである。バ ラスト基は8以上の炭素数を有する、写真性に対して比

較的不活性な素であり、例えばアルキル藻、アラルキル 基、アルコキシ基、フェニル基、アルキルフェニル基、 フェノキシ基、アルキルフェノキシ基などの中から選ぶ ことができる。またポリマーとしては、例えば特別平1 -100530号に記載のものが挙げられる

【0149】本発明の一般式(1)~一般式(3)で表され る化合物は、その中にカチオン性基(具体的には、4級 のアンモニオ基を含む基、または4級化された窒素原子 を含む含窒素ヘテロ環基等)、エチレンオキシ基もしく はプロピレンオキシ基の繰り返し単位を含む基。 (アル キル、アリール、またはヘテロ環) チオ基、あるいは塩 基により解離しうる解離性基(カルボキシ基、スルホ 基、アシルスルファモイル茶、カルバモイルスルファモ イル基等) が含まれていてもよい。特にエチレンオキシ 基もしくはプロピレンオキシ基の繰り返し単位を含む 基、あるいは(アルキル、アリール、またはヘテロ環) チオ基が含まれているものは、本発明の好ましい例の1 つである。これらの基の具体例としては、例えば特膜平 7-234471号、特開平5-333466号、特開 平6-19032号、特開平6-19031号、特際平 5-45761号、米国特許4994365号、米国特 許4988604号、特開平3-259240号、特開 平7-5610号。特爾平7-244348号。 %国特 許4006032号等に記載の化合物が挙げられる。 【0150】次に本発明の一般式(1)~一般式(3)で表 される化合物の具体例を以下に示す。ただし、本発明は

[0151]

以下の化合物に限定されるものではない。

[0152]

[0158] 【化10】

【0160】本売明の一般式(1)~一般式(3)で業を入る化合物は、水または適当な有能溶媒、例えばアルコル類 (メタノール、エタノール、プロパノール、ファ素化アルコール)、ケトン類 (アセトン、メチルエチルン・トン、)、ジメチルルルインド、ジメチルルルインド、メチルセロソルブなどに溶解して用いることができ、メチルセロソルブなどに溶解して用いることができる。

[0161]また、既によく知られている現化分散法によって、ジブチルフタレート、トリクレジルフォスフェート、グリセリルトリアセテートあるいはジエチルフタレートなどのオイル、耐酸エチルやシクロへキサノンなどの細助溶線を用いて溶解し、機械かに乳化分散物を作型に入れている方法によって、化合物の物末を水等の適当な溶媒中にボールミル、コロイドミル、あるいは超音波によって分散し用いることができん。あるいは超音波によって分散し用いることができん。あるいは超音波によって分散し用いることができん。

【0162】本発明の一展式(1)~一様式(3)で表され る化合物は、支持体に対して面像形成層限の層、即ち画 億形成層あるいはよこの原則のどの層に添加してもよい が、画像形成層あるいはそれに隣接する層に添加するこ とが好ましい。

【0163】本発明の一般式(1)~一般式(3)で表される化合物の添加量は、額1モルに対し1×10・6~1モルが好ましく、1×10・5~5×10・1モルが患も好ましく、2×10・5~2×10・1モルが患も好ましい。 【0164】一般式(1)~一般式(3)で表される化合物 は公知の方法により容易に合成することができるが、例 えば、米国特許5545515号、米国特許56353 3号、米国特許654130号、国際特許WO-9 7/34196号、あるWは特罰平9-354107 号、物間平9-309813号、特間下9-27220 受挙に駆撃のが変せ参考に企成することができる。

【0166】本発明に超硬調化剤として用いられるヒド ラジン誘導体は、下記一般式(H)によって表わされる 化合物が好ましい。

[0167]

【化12】

一般式(H)

【0169】一般式(H)において、R¹²で表わされる 脂肪族基は好ましくは炭素数1~300産後もしくは無電 損の、直鎖、分岐または環状のアルキル基、アルケニル 基、アルキニル基である。

[0170] 一般式(旧)において、Riで乗わされる 芳香族鉱は単張もしくは縮合類のアリル基で、例えば フェニル基、ナフチル基が挙げられる、Riで乗わされる へ予で顕基としては、単環または縮合類の、飽和もし は不能和の、芳香族または非芳香族のへ予ロ環塞で、 ほんちの塞中のヘテロ環としては、例えば、ピリジン 環、ピリミジン環 イミグゲール環、ナラソール環、キ アソール環、ペングキアゾール環、トリアシン環、 が途呼がられる。モベルラン環 が必挙がない、モベリジン環、ビベラシン環 がが挙げられる。

【0171】R¹²として好ましいものはアリール基もし くはアルキル基である。

【0172】R12は置換されていてもよく、代表的な置 機基としては例えばハロゲン原子 (フッ器原子、クロル 原子、臭素原子、または沃素原子)、アルキル基(アラ ルキル基、シクロアルキル基、活性メチン基等を含 む)、アルケニル基、アルキニル基、アリール基、複素・ 環基、4級化された窒素原子を含むヘテロ環基(例えば ピリジニオ基)、アシル基、アルコキシカルボニル基、 アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、カルボ キシ基またはその塩、スルホニルカルバモイル基、アシ ルカルバモイル基、スルファモイルカルバモイル基、カ ルバゾイル基、オキサリル基、オキサモイル基、シアノ 基、チオカルバモイル基、ヒドロキシ基、アルコキシ基 (エチレンオキシ基もしくはプロピレンオキシ基単位を 繰り返し含む基を含む)、アリールオキシ基、ヘテロ環 オキシ基、アシルオキシ基、(アルコキシもしくはアリ ールオキシ) カルボニルオキシ基、カルバモイルオキシ

基、スルホニルオキシ基、アミノ基、(アルキル、アリ ール、またはヘテロ環)アミノ基、N-置換の含窒素ヘテ ロ環基、アシルアミノ基、スルホンアミド基、ウレイド 基、チオウレイド基、イミド基、(アルコキシもしくは アリールオキシ) カルボニルアミノ基、スルファモイル アミノ基、セミカルバジド基、チオセミカルバジド基、 ヒドラジノ基、4級のアンモニオ基、オキサモイルアミ ノ基、(アルキルもしくはアリール)スルホニルウレイ ド基、アシルウレイド基、アシルスルファモイルアミノ 基、ニトロ基、メルカプト基、 (アルキル、アリール、 またはヘテロ環)チオ基、(アルキルまたはアリール) スルホニル基。(アルキルまかはアリール)スルフィニ ル基、スルホ基またはその塩、スルファモイル基、アシ ルスルファモイル基、スルホニルスルファモイル基また はその塩、リン酸アミドもしくはリン酸エステル構造を 含む基、等が挙げられる。

【0173】これら置換基は、これら置換基でさらに置 換されていてもよい。

(0174) Riiが広省していてもよい電換蓋として好ま しいものは、Riiが茂香族蓋またはヘテロ環基を表す場 る、アルキル基(活性メチレン基を含む)、アラルキル 思、ペテロ環底、置換アミノ恋、アシルアミノ塞、スル オンアミド基。ウレイド基、スルファモイルアミノ基、 イミド塞、チオウレイド薬、リン酸アミド薬、とドロキ シ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシルオキシ 基、アシル薬、アルコキシカルボニル薬、アルロ・オンカルボニル薬、アルコキシカルボニル。 類を含む)、(アルキル、アリール、またはヘテロ環) チオ基、スル本蓋(その塩を含む)、スルファモイル 悪、ハロゲン原子、シアノ蒸、ニトロ基等が挙げられ る。

【0175】またRiiが脂肪族差を表す場合は、アルキル塞、アリール塞、ヘテロ構造、アミノ落、アシルアミ ノ差、スルボンドミ港。ウルイド基、スリントでトリース デミノ落、イミド港、チオウレイド基、リン酸アミド ボンルオキシ港、アルコキシ達、アリールオキシ基、 アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、カルボ キシ基(その塩を含む)、(アルキル、アリール、また はヘテロ関・チオ基、スルホ差(その塩を含む)、スル ファモイル差、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基等が 繋まりか。

【01761 一般式(B) において、R¹¹は水源原子またはプロック盖を表すが、プロック盖とは具体的に、脂肪族 具体的にはアルキル基、アルケニル基、アルキニル基)、芳香族基(単環もしくは暗合環のアリール 本・ケースの悪族、アルコキシ盖、アリールオキシ基、アリールオキシ基、アン・基またはヒドラジノ基を表す。

【0177】R¹¹で表わされるアルキル基として好まし くは、炭素数1~10の置換もしくは無置換のアルキル基 であり、例えばメチル基、エチル基、トリフルオロメチ ル基、ジフルオロメチル基、2-カルボキシテトラフルオ ロエチル基、ピリジニオメチル基、ジフルオロメトキシ メチル基、ジフルオロカルボキシメチル基、3-ヒドロキ シプロピル基、3-メタンスルホンアミドプロピル基、フ ェニルスルホニルメチル基、o-ヒドロキシベンジル 基、メトキシメチル基、フェノキシメチル基、4-エチル フェノキシメチル基、フェニルチオメチル基、t-ブチル 基 ジシアノメチル基 ジフェニルメチル基 トリフェ ニルメチル基、メトキシカルボニルジフェニルメチル 基、シアノジフェニルメチル基、メチルチオジフェニル メチル基などが挙げられる。アルケニル基として好まし くは炭素数1~10のアルケニル基であり、例えばビニル 基、2-エトキシカルボニルビニル基、2-トリフルオロ-2 メトキシカルボニルビニル基等が挙げられる。アルキ ニル基として好ましくは炭素数1~10のアルキニル基で あり、例えばエチニル基、2-メトキシカルボニルエチニ ル基等が挙げられる。アリール基としては単環もしくは 縮合環のアリール基が好ましく、ベンゼン環を含むもの が特に好ましい。例えばフェニル基、パーフルオロフェ ニル基、3、5-ジクロロフェニル基、2-メタンスルホン アミドフェニル基、2-カルバモイルフェニル基、4、5-ジシアノフェニル基、2-ヒドロキシメチルフェニル基、 2.6-ジクロロー4-シアノフェニル基、2-クロロー5-オクチ ルスルファモイルフェニル基などが挙げられる。

[0178] ヘテロ環塞として好きしくは、少なくとも 1つの産業、酸素、および環境原子を含むから長の、農 和もしくは不能和の、単環もしくは精金環のヘテロ環塞 で、例えばモルホリン塞、ビベリジノ塞(ト置娘)、イミ ゲアリル塞、インダブリル港、ペニンベンリルを 等)、とラゾリル基、トリアゲリル基、ペンダイミタグ リル塞、テトラゾリル基、とリジル基、とリジニオ基 (ドンオル・ランビリジニオ基等)、キノリニオ塞、キノ リル本をとがおり、

【0179】アルコキシ基としては炭素数1~8のアルコ キシ基が好ましく、例えばメトキシ基、2-ヒドロキシエ トキシ基、ベンジルオキシ基、t-プトキシ基等が挙げら れる。アリールオキシ基としては置換もしくは無置換の フェノキシ基が好ましく、アミノ基としては無置換アミ ノ基、および炭素数1~10のアルキルアミノ基、アリー ルアミノ基、または飽和もしくは不飽和のヘテロ環アミ ノ基(4級化された窒素原子を含む含窒素ヘテロ環アミノ 基を含む〉が好ましい。アミノ基の例としては、2,2,6,6 -テトラメチルピペリジン-4-イルアミノ基、プロピルア ミノ基、2-ヒドロキシエチルアミノ基、アニリノ基、o -ヒドロキシアニリノ基、5-ベンゾトリアゾリルアミノ 基、N-ベンジル-3-ビリジニオアミノ基等が挙げられ る。ヒドラジノ基としては置換もしくは無置機のヒドラ ジノ基、または置換もしくは無置換のフェニルヒドラジ ノ基(4-ベンゼンスルホンアミドフェニルヒドラジノ基 など)が特に好ましい。

【0180】R¹¹で表される基は置換されていても良く、その置換基の例としては、R¹²の置換基として例示したものがあてはまる。

【0181】一般式(用) においてR¹¹はG¹-R¹¹の部分 を残余分子から分裂させ、G¹-R¹¹部分の原子を含む環 式構造を生成させる現化反応を生むするようなものであ ってもよく、その例としては、例えば特開明G3-29751号 などに記載のものが挙げられる。

【0182】一児式(用)で表されるドドラン/誘導体は、ハロゲン付機に対して吸着する吸着性の差が組み込まれていてもよい、こうした吸着菌としては、アルナチオ素、アリールチオ素、チオ尿素薬、チオ尿素薬、メルカアト技術環塞、トリアゾール基本との米国特計等4、385、108%、両4、459、347号、特別形259-201046号、同69-201046号、特別・201046号、同69-201046号、同69-201046号、同69-201046号、同69-201046号、市69-201046号、配69-201046号、元69-201046号、

【0183】一般式(用)のR11またはR11はその中に カプラー等の不動性写真用添加剤において常用されい が写えた基本とはポリマーが組み込まれているもので もよい。パラスト基は30上の炭素数を有する、写真性 に対して比較的不活性な苦であり、例えばアルキル基、 アカルキル型、アルコキン型、フェルー基、アルキルフェ エル基、フェノキシ基、アルキルフェノキシ基などの 中から選ぶことができる。またポリマーとしては、例え ば特開子10万30号に整数ものが挙げられる。

【0184】一冊式(用)の記りまたは記りは、置換差としてヒドラジン基を接取暗なんでいてもよく、この時一般式(用)で表される化合物は、ヒドラジン基に関しての多様体を表し、具体的には例えば時間昭6-6613 号、特額平4-16938号、特額平7-57132号、特額平7-57132号、特額平7-57132号、特額平7-57132号、特額平7-57132号、特額平7-57132号、特額平7-57132号、特額平7-57132号、共和軍7-57132号、共和国7-571

号、特開平6-19031号、特開平5-45761号、米国特許4,99 4,365号、米国特許4,988,604号、特開平3-259240号、特 周平7-5610号、特開平7-244348号、独国特許4,006,032 号等に記載の化合物が挙げられる。

(0186) 一般式(目)においてれ、水は水素原子 炭素敷20以下のアルキルまたはアリールスルホニル基 (好ましくはフェニルスルホニル基、またはパメットの 置換基定数の和が・0、5以上となるように置換されたフェニルスルホニル基)、炭素敷20以下のアンル基(好ま とくはベンアイル基、またはバメットの置接差定数の和が・0、5以上となるように置換されたペンゲイル基、あ るいは直鎖、分娩、もしくは環状の置換または無置換の 脂肪族アンルを (こたに置換を上しては、例えばハロゲン原子、エーテル基、スルホンアミド基、カルボンアミド基、とドロキシ基、カルボキシ基、スルホ蒸等が挙げ られる))である。

【0187】A¹、A² としては水素原子が最も好まし

【0188】次に本発明において、特に好ましいヒドラ ジン誘導体について述べる。

【0189】R¹²はフェニル基または炭素数1~3の置換 アルキル基が好ましい。

[0190] R¹¹がフェニル基を費す時、その貯ましい 置換差としては、ニトロ基、アルコキシ基、アルキル 素、アシルアラン基、ウレイド基、スルホンアミド基、 チオウレイド基、カルバモイル基、スルファモイル基、 カルボキン基(またはその趣)、スルホ基(またはその 塩)、アルコキシカルボニル基、またはクロル原子が挙 げられる。

[010] Pは小煙増ウェニル基を表す時、その置換 蒸に、直接または連結基を介して、パラス 蒸、ハロゲ ン化型への吸着拡、4線のアンモニオ基を含む基、4線化 された型素原子を含む含塑素へテロ環塞、4球化 シ基の補り返し単位を含む塞、(アルキル、アリール、 シルアまノ基、スルホンテミド基、解解性基(カルボキ シ基、スル市基、アシルスルファモイル基、カルバキ シェ、スル市と、アシルスルファモイル基、カルバキ とは、クトロメーターとは、多単位を形成しうる とドラン/基 (一部所に一足りで表される感) の少なく とも1つが開始されているととがり かなし、

[0192] 早!が炭素酸1~3の運費アルキル基を表す 時、 P:12は70番目とくは電池メチル基であり、さらに は、二電塊メチル基もしくは三電塊メチル基が好まし く、その電損基としては炭体的に、メチル基、アェニル 環)チオ基、アルコキシ基、アリール、またはヘテロ 環)チオ基、アルコキシ基、アリールオキシ基、クロル 原子、ヘテロ環基、アルコキシカルがにル基、アリール オキシカルボニル基、カルドモイル素、スルファモイル 基、アミン基、アシルアミン基、またはスルオンアミド 基が容まし、外に置換もしくは無難的フェニル基が 好主しい。

【0193】 R*いが置換メタル基を表す時、より放ましい。 以具体倒としては、ヒブチル基、ジンアノメチル連、ジ シアノフェニルメチル連、トリフェニルメチル連、グ ナル邁、ジフェニルメチル基、メトキシカルボニルジ フェニルメチル基、シアンジフェニルメチル連、アン チル邁、シフェニルメチル基、シウロプロビルジフェニルメ チル基をどが挙げられるが、中でもトリチル基が最も好 ましい。

【0194】一般式(H) においてR12は、最も好まし くは置換フェニル基である。

【0195】一般式 (H) においてmiはiまたは20を表す が、miかの時、R) は脂肪族基、芳香族基、またはへ プロ環基を表す。miがの時、R) は特に好ましくはフェニル基まなは2世素数1~3の度増アルキル基であり、これは先に説明とたR12の舒ましい範囲と同じである。

【0196】m1は好ましくは1である。

【0197】Rいで表わされる基のうちだましいらのは、Ritがフェニル基を表し、かつのが一の基の場合は、水寒原子、アルキル基、アリール基、アリール基、またはヘテロ環基であり、さらに好ましくは水寒原子、アルキル基、アリールをある。ここでRiがアルキル基を表す時、その置換基としてはハロゲン原子、アルコキン基、アリールオマン基、アルキルチオ基、アリールチオ基、カルボキン基が伸に好ましい。【0198】Riが置換メチル基を表し、かっなが一個表の場合には、Riは好ましくは水寒原子、アルキルスル

※の増加され、私・社会ましては八水地ボ・ハルイル 素、アリール差、ヘテロ環塞、アルキル下ミノ塞、アリールアミノ 塞、ヘテロ環アミンဆ)であり、さらに好ましくは水素 原子、アルキル・強、アリールで、ヘアロ環塞、ハルコキ シ雄、アルキル・アミノ塞、ヘアロ環 アミノ塞である。Gが ←000 基の場合には、R:14に関わ らず、R:14でアルコキシ差、アリールオキシ差、アミノ 基が好ましく、特に置換アミノ塞、詳しくはアルキルア ミノ基、アリールアミノ楽、または絶和もしくは不飽和 のヘテロ環アミノ基が好ましい。

【0199】またC¹が-SO₂-基の場合には、R¹²に関わ らず、R¹¹はアルキル基、アリール基または置換アミノ 基が好ましい。

【0200】一般式(H)においてG!は好ましくは-CC-基または-CCC-基であり、特に好ましくは-CC-基であ

【0201】次に一般式 (H) で示される化合物の具体 例を以下に示す。ただし、本発明は以下の化合物に限定 されるものではない。

[0202]

【表1】

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} 5 \\ \end{array} \\ X \end{array} \begin{array}{c} \begin{array}{c} 0 \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} 1 \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} 0 \\ \end{array} \\ \end{array} \begin{array}{c} 0 \\ \end{array} \\ \\ \begin{array}{c} 0 \\ \end{array} \\ \\ \end{array} \\ \begin{array}{c} 0 \\ \end{array}$$

	X = R =	-н	-C ₂ F ₄ -COOH (^{\$ \times \text{it} \text{G} \text{\$\exitit{\$\ext{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\exitit{\$\text{\$\exitit{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\}	-∕_> сн₂он	-conh-{>
1	3-NHCO-C ₉ H ₁₉ (n)	1a	1b	1c	1d
2	3-NHCON: +\^S-C ₇ H ₁₅ (n)	?a	2b ,	20	2d
3	3-NHCOCH ₂ -N	3a	3b	30	3d
4	CH ₃ ⊕1 3-NHCOCH ₂ -N-C ₈ H ₁₇ CH ₃ CIΘ	4a	4b	4c	. 4d
5	3-NHCO	5a	5b	50	5d
6	3-NHCONH N	6a	6b	6c	6d
7	2,4-(CH ₃) ₂ -3- SC ₂ H ₄ -(OC ₂ H ₄) ₄ -OC ₈ H ₁₇	7a	7b	7c	7d

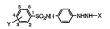
[0203]

【表2】

	R = X =	~н	−CF ₂ H	-CH ₂ -N CI ^O	-сохн-Стн
8	Ç₂H₅ 3-CONHCH₂CH-C₄H₅	8a	8e	8f	8g
9	6-OCH ₃ -3-C ₅ H ₁₁ (t)	9a	90	9f	9g
10	3-N N	10a	10e	10f	10g
11	3-NHCOCH ₂ SCH Q	11a	11e	11f	11g
12	N-N 4-NHCOCH₂-S≺ _S ⊁SH	12a	12e	12f	12g
13	3-NHCOCH-C ₈ H₁ ₇ I CH₂COOH	13a	13e	13 f	i3g
14	Ç₂H ₆ 3,5-{CONHCH ₂ CH-C₄H ₉) ₂	14a	149	14f	14g

[0204]

【表3】



	X = Y=	~сно	-COCF ₃	-SO ₂ CH ₃	O - -P(OC ₂ H ₅) ₂
15	з-инсосн₂ и_>солнс₄н₄ ⊖а .	15a	15h	15i	15j
16	4-NHCO(CH ₂) N - C ₆ :1 ₁₉	16a	16h	16i	16j
17	3-505NH~(0~)4004H9	17a	17h	171	17j
18	CH ₃ I 3,4-(COOCHCOOC₄H ₉) ₂	18a	18h	18i	18]
19	3-NHCO ~ s.s	19a	19h	19i	19j
20	8-NHSO ₂ NH-C ₈ H ₁₇	20a	20h	20 i	20j
21	SH ≥-Cl-5-N 2-Cl-5-N	21a	21h	21i	21j

[0205]

【表4】

	A=	H	−CF ₃	-CH₂-(CH OH	-conh
22	N:N SO2NH- NHNH R	22a	22h	22k	221
23	CAPTOCHERARDONE ON NO. NO. NO. NO. NO. NO. NO. NO. NO.	23a	23h	23k	231
24	CH3C II	24a	24h	24k	241
25	C10H21-N SO ₂ NH- NHNH P	25a	25h	25k	251
26	SO ₂ NH-()-N:BNH R SO ₂ NH-()-N:BNH R R NH-NH-()-NH-SO ₂	26a	26h	26k	261
27	CO-(1)-SO2NH-(1)-NHNH AR (1) CO-(1)-SO2NH-(1)-NHNH AR	2/a	27h	27k	271
28	NHCO CONH CONH CONH SO₂NH-C-NHNHR	28a	28h	28k	281

[0206]

【表5】



	R = Y =	Н	-CH₂OCH₃	Q _{NH} ≪∑ ^N _H	- CH ₂ -N
29	\$ 4-NHCNH-C ₈ H ₁₇ (n)	29a	29m	29n	291
30	0 4-NHP (0 CH2-⟨_)2	30a	30m	30n	30f
31	4-NHCONH-(CH2)30 (∑)	31a	31m	31n	31f
32	4-OH C ₂ H ₅ 3-NHCONHCH ₂ CH-C ₄ H ₉	32a	32m	32n	32f
33	4-NH80 ₂ (OH ₂) ₂ NHOO	33a	33m	33n	33f
34	4-0Clf ₂ -{}	34a	34m	34n	34f
35	4-NHCONHN (СН2-СС)2	35a	35m	35n	35f

[0207]

【表6】

	R = Y =	-н	-CF ₂ SCH ₃	CONHCH ₃	-Q-NO₂ NO₂
36	2-NHSO ₂ CH ₃ - 4-NHCONH(CH ₂) ₃ -(H)	36a	360	36р	36q
37	2-OCH ₃ - 4-NHSO ₂ C ₁₂ H ₂₅	37a	370	37p.	37q
38	3-NHCOC ₁₁ H ₂₃ - 4-NHSO ₂ CF ₃	38a	380	38p	38q
39	4-N CONHC ₈ H ₁₇	39a	390	39p	39q
40	4-0CO(CH ₂) ₂ COOC ₆ H ₁₃	40a	400	40p	40q
41	SH 4-NHCONH- N-N CH ₃	41a	410	41p	41q
42	4-NIHCO	42a	420	42p	42q

[0208]

【表7】

43	
44	CH ₃ -C)-SO ₂ NH-()-NHNH ()-CH ₂ COCH ₃
45	CF ₃ CO. H - C N - NH - C NH - C NH - NH
46	ONH NHOE
47	$\begin{array}{c} -\text{CH}_2\text{CH} \frac{1}{\chi} & \text{CH}_2\text{CH} \frac{1}{\gamma} \\ \text{CO NH-} SO_2\text{NH-} \text{NHN-4COCF}_3 & \text{CONICH}_3 \\ \text{XY} = 3:97 \\ \text{?**} + 23:97 \\ \text{?***} + 23:97 \\ \text{?****} + 23:97 \\ \text{?*****} + 23:97 \\ \text{?*******} + 23:97 \\ ?************************************$
48	CO - NHNH- NHSO ₂ - CH ₈
49	SOUNH SOUNH SOUNH NHNH NHNH NHNH NHNH
50	CO NHCONH- NHANH CO NH CH₂-CO

[0209]

51	NHSO ₂ NiH \ NI IN - C- \ OCCF ₃
52	SO ₂ NH-NHSO ₂ CH ₃ NHNHSOCH ₉
53	C ₀ F ₁₇ SO ₂ NH-⟨NHNH NHCH ₃

[0210]

	R : Y=	-н	−СН₂ОСН₃	-сн₂о-⟨)	-CONHC3H7
54	2-OCH ₃	54a	54m	54r	54s
55	2-OCH ₃ 5-C ₈ H ₁₇ (t)	55a	55m	55r	55s
56	4-NO ₂	56a	56m	56r	56s
57	4-CH₃	57a	57 m	57r	57s
58	4-NHCO-	58a	58m	58r	58s
59	O 4-NHCN CH ₂ -C	59a	59m	59r	59s

[0211]



	Y = R =	-н	-√ CH₂ΩH	-CH₂ ·N_ •Cl [©]	-соин-Син
60	2-OCH ₃ 5-OCH ₃	60a	60c	60f	60g
61	4-C ₈ H ₁₇ (t)	61a	61c	61f	61g
62	1-OCH₃	62a	62c	62f	62g
63	3-NO ₂	63a	63 c	63f	63g
64	4-NHCO −€NO₂	64a	64c	64f	64g
65	4-NHCNH	65a	65c .	65f	65g

[0212] 【表11】

$$\begin{array}{c} O\\ II\\ R_A-NHNH-C-R_B \end{array}$$

	R _A =	-н	-сн₂о ⟨_}-ло₂	-{_}-K,CH3	-NH-
66	0-0-0	66a	66u	66v	66t
67	сн _° о-Сн _°	67a	67u	67v	67t
68	000	68a	68u	68v	68t
69	0 0 0	69a	69u	69v	69t
70	() () () () () () () () () () () () () (70a	70u	70v	70t
71	CONHC3H7	71a	/1u	71v	71t

[0213]

【表12】

O II R_A--NHNH -C-R_B

	R _B =	O -CNHC ₃ H ₇	O II CO -C ₄ H ₉ (t)	-OC ₄ H ₉ (t)	~C^
72		72s	72x	72y	72w
73	×0-0-<	73\$	73x	73y	73w
74		74s	74x	74y	74w
75	O - CO₂CH₂-(C)	75s	75x	75y	75w
76	O-CONH-O	76s	76x	76y	76w

[0214]

【表13】

	R=
77	ONHCNH - NNNN
78	−CH₂SCH₂CH₂SO₂−⟨
79	. −CH₂OCH₂CH₃SCH₂CH₅OCH₅
80	−CF ₂ CF ₂ COOH
81	-CH ₂ OCH ₂ S-K _S -SH
82	-c;+₂-N • cl⊖

[0215]

83	рыни ф Н
84	NC—CI NHNH CHO
85	O₂N - NHNH CHO
86	O ₂ N——NHN CHO
87	NHN CHO
88	NHN SO ₂ -CH ₃

[0216]

【表15】

89	O ₂ N-\NHNH-_NHNH-_NO ₂
90	C(CH ₃) ₂ SO ₂ -CH ₃
91	-50 ₂ NI+
92	NC — NHNH N(C ₂ H ₆) ₂
93	CH ₉ SO ₂ —NHNHCHO SO ₂ CH ₈
94	H ² NHNH-Q-o-Q-NHNH ² H

【0217】 【表16】

5 6	0
⁴€∑¹n∺n∺-	-KB
V V	-0 11

	R = Y =	-0H≥O-Q}-C;H¢	-сно-ФҢ	-сн₂s-⟨_}	CH ₂ -CI
95	4-NHCOCHO-{_}\-\ c₂H₅ \	95-1	95-2	95-3	95-4
96	4-COOH	96-1	96-2	96 3	96-4
97	S 4-NH NHC₂H₅	97-1	97-2	97 3	97-4
98	4-NHSO ₂ -{_> NHCOC ₉ H ₁₉	98-1	98-2	98-3	98-4
99		99-1	99-2	99-3	99-4
100	4-NHCONHCH2CHC2H5	100-1	100-2	100-3	100-4

[0218]

【表17】



	X = Y =	CH ₂ SO ₂ -©	-802√∑+CH5	Å Ö	CH ₃ O+CH ₃ CH ₃
101	4-NO ₂	101-5	101-6	101-7	101y
102	2,4-OCH ₃	102-5	102-6	102-7	102y
103	4-мнсосн₂о-€УҢ	103-5	103-6	103-7	103y
	X = Y =	² ×H ◆		i C	CH3 CH3 CH3
104	4-NHCONH✓SC₄H₃	104-8	104-9	104wʻ	104x
105	4-NHSO ₂ -CO ₂	105-8	105-9	105w'	105x

[0219]

【表18】

Y-NHNH-X

	X = Y =	Å a	묏	СН2ОСН3	CH3 CH3
106	CH ₉ CH ₉ −C— CH ₃	i06-10	106a	106m	106y
107		107-10	107a	107m	107y
108		108-10	108a	108m	108y
109	C-C-S	109-10	109a	109m	109y
110	CN CH ₃ -C- CH ₃	110 10	110a	110m	110y
111	(sXCH3	111-10	111a	111m	11 î y

[0220]

【表19】

Y-NHNH-X

	Y = X =	CI CN	0 0 0	CN -C-CH ₃ CH ₃	SO ₂ CH ₃
112	NC—CI	112-11	112-12	112-13	112-14
113		113-11	113-12	113-13	113-14
114	CH ₈ -C- CH ₈	114-11	114-12	114-13	114-14
115	CONHC ₃ H ₇	115-11	115-12	115-13	115-14
116	O ₂ N-___\NO ₂	116-11	116-12	116-13	116-14
117		117-11	117-12	117-13	117-14

[0221]

【表20】

118	O—C—NHNH—SO₂—CH₃
119	() () () () () () () () () ()
120	O-c-NHNH NHNH -c-O
121	OCH ₃ CH ₃ O CH ₃ O
122	
123	O-C-NHNH-O-NH-C-O

【0222】 【表21】

O Ar-NHNH-C-CH₂-X

Г	X=	1					Γ
124	Ar=	-OH	-SH	-NHCOCI'3	-NHSO ₂ CH ₃	-NHSO₂ph	-N(CH ₃) ₂
124	⊘ + '	124a	124b	124c	124d	124e	124f
125		125a	125b	125c	125d	125e	125f
126	OCH ₃	126a	126b	126c	126d	126e	126f
127	a ⇔ cı	127a	127b	127c	12/d	1270	127f
128	C ₆ H ₁₃ SCH ₂ CONH -	128a	128b	128c	128d	128e	128f
129	SH SO ₂ NH	129a	129b	129c	129d	129e	129f
130		130a	130b	130c	130d	130e	130f
131	<;D	131a	131b	131c	131d	131e	131f
132	0-0-	132a	132b	132c	132d	132e	1321
133	H-s-4n	133a	133b	133c	133d	133e	133f
134	CL COOH	134a	134b	134c	194d	134e	134f

【0223】 【表22】

135	NC_COOC ₂ H ₅
136	C7H15CONH—NHINH
197	NC-NHAN-1

[0224] 一級式(日) で表わされるとドラシン博弈 体は1種のみ用いても、2種以上を併用しても良い。 [0225] 本売時に用いたれるとドラジン精験体とし ては、上配のものの他に、下配のヒドラジン精験体も好 ましく用いられる、(場合によっては組み合わせで) 明いることもできる。) 本売明に用いられるとドラジン誘導 体は並な、下配の物料に加載された種々の方法により、 合成することができる。

【0226】特公平6-77138号に記載の(化1)で表され る化合物で、具体的には同公報3頁、4頁に記載の化合 物。特公平6-93082号に記載の一般式(I)で表される 化合物で、具体的には同公報8頁~18頁に記載の1~38の 化合物。特開平6-230497号に記載の一般式(4)、一般 式 (5) および一般式 (6) で表される化合物で、具体的 には同公報25頁、26頁に記載の化合物4-1~化合物4-1 0、28頁~36頁に記載の化合物5-1~5-42、および39頁、 40頁に記載の化合物6-1~化合物6-7。特開平6-289520号 に記載の一般式(1)および一般式(2)で表される化合 物で、具体的には同公報5頁~7頁に記載の化合物1-1) ~1-17) および2-1) 、特勝平6-313936号に記載の(化 および(化3)で表される化合物で、具体的には同公 報6頁~19頁に記載の化合物。特開平6-313951号に記載 の(化1)で表される化合物で、具体的には同公報3頁~ 5頁に記載の化合物。特開平7-5610号に記載の一般式 (I)で表される化合物で、具体的には同公報5頁~10 頁に記載の化合物 I-1~ I-38。特開平7-77783号に記載 の一般式(11)で表される化合物で、具体的には同公報

10頁~27頁に記載の化合物II-1~II-102。特開平7-1044

(B)、一成以(b)、一成以(b)、一成以(b)、一 根式(F)で表される化含物で、具体的には同公帳に記 載か化合物・1~14·30。特別平9-22082号に記載の一般式 (1)で表される化合物で、具体的には同公帳に記載の 化合物D-1~D-55。

【0227】さらに1991年3月22日発行の 公知技術(1~207頁)、(アズテック社刊)の25頁から34頁に記載の種々のヒドラジン誘導体、特開昭62~86354号(6頁~7頁)の 化合物 D-243よびD-39。

【0228】本郊男のとドラジン誘導体は、適当な有機 溶緩、例えばアルコール類(メタノール、エタノール、 プロパノール、フッ素化アルコール)、ケトン類(アセ トン、メチルエチルケトン)、ジメチルホルムアミド、 ジメチルスルホキシド、メチルセロソルブなどに溶解し て用いることができる。

【0229】また、既によく知られている乳化分散法によって、ジブチルフタレート、トリクセジルフォスフェート、クリセリルトリアセテートあるいはジエチルフタレートなどのオイル、削酸エチルやシクロヘキサノンなどの細胞溶媒を用いて溶解し、機械的に乳化分散物を作取しなったがある。あるいは当面体分散法として知られている方法によって、ヒドラジン誘導様の物味を

水の中にボールミル、コロイドミル、あるいは超音波に よって分散し用いることができる。

[0230]本発明のヒドラジン誘導体は、支持体に対して画像形成層側の層、即ち画像形成層あないはこの層 側の他のどの層に添加してもよいが、画像形成層あるいはそれに障後する層に添加することが好ましい。

【0231】本発明のヒドラジン誘導体の添加量は、録 1モルに対し1×10⁻³~1×10⁻²モルが好ましく、1×10⁻⁵ ~5×10⁻³モルがより好ましく、2×10⁻⁵~5×10⁻³モル が載も好ましい。

[0232]また、本発明は被要調画機形成のために、前記の超硬調化例とともに硬調化促進剤を併用することができる。例えば、米田特許第5,545,505号に電域のアミン化合物、具体的にはAMーへAM-5、同5,545,507号に記載のアドロキサム路類、具体的にはAHA-1へHA-11、同5,545,507号に記載のアクリロニトリル類、具体的にはCN-1〜CN-13、同5,555,983号に記載のドドラジン化合物、具体的にはCA-1〜CA-6、日本特許特額平8-132836号に記載のオニューム塩類、具体的にはCA-1〜CA-45、世界特別を記載のオニューム塩類、具体的にはCA-1〜CA-45、日本・10年20年間にあることができる。

【0233】前記の超硬調化剤、および硬調化促進剤の 合成方法、添加方法、添加量等は、それぞれの前記引用 特許に記載されているように行うことができる。

【0234】本発明における増密色素としてはハロゲン 化鎖粒子に吸棄した際、所編の淡長領域でハロゲン化 数数子を分光端壁できるもので有ればいかなるものでも良い、増感色素としては、シアニン色素、メロシアニン色素、ステリアックスメロシアニン色素、ホロボーラーシアニン色素、スチリル色素、ヘミシアニン色素、オキソノール色素を目的ることができる。本発明に使用される有用な構造を無対向とは常SEARCH DISCLUSIE Itea和 (1978年12月。23)、同Itea和3以項(1979年8月。437)に記載もしくは3月月 された文献に記載されている。特に各種レーザーイメージャー、スキャナー、イメージャッターや製版カメラの光流の分光特性に達した分光感度を有する増感色素を有利に選択することができ

[0235]赤色学への分光速感の例としては、In-Heレーザー、赤色半導体レーザーや1.Dbなどのいわゆる赤と窓側に対しては、特開野54-18726号に記載の1-1から1-35の化合物、特期平6-7532号に記載の1-1から1-35の化合物、また7特別平7-28733号に記載の1-1から1-37の化合物および特別平7-28733号に記載の1-1から1-37の化合物および特別平7-28733号に記載の1-1から1-34の化合物などが有利に影響の45-284343号に記載の1-1から1-34の化合物などが有利に影響の45-284343号に記載の1-1から1-34の化合物などが有利に影響なども、2583号と18-34の化合物などが有利に影響なども、2583号と18-34の化合物などが有利に影響なども、2583号と18-34の化合物などが有利に影響なども、2583号と18-34の化合物などが有利に影響なども、2583号と18-34の化合物などが有利に影響なども、2583号と18-340号に対している。2583号と18-340号に対している。2583号と18-340号に対している。2583号と18-340号に対している。2583号と18-340号に対している。2583号と18-340号に対している。2583号と18-340号に対している。2583号に対

【0236】750~1400nmの波長領域の半導体レーザ 一光源に対しては、シアニン、メロシアニン、スチリ ル、ヘミシアニン、オキソノール、ヘミオキソノールお よびキサンテン色素を含む種々の既知の色素により、ス ペクトル的に有利に増感させることができる。有用なシ アニン色素は、例えば、チアゾリン核、オキサゾリン 核、ピロリン核、ピリジン核、オキサゾール核、チアゾ ール核、セレナゾール核およびイミダゾール核などの塩 基性核を有するシアニン色素である。有用なメロシアニ ン染料で好ましいものは、上記の塩基性核に加えて、チ オヒダントイン核、ローダニン核、オキサゾリジンジオ ン核、チアゾリンジオン核、バルビツール酸核、チアゾ リノン核、マロノニトリル核およびピラゾロン核などの 酸性核も含む。上記のシアニンおよびメロシアニン色素 において、イミノ基またはカルボキシル基を有するもの が特に効果的である。例えば、米国特許3,761,279号、 同3,719,495号。同3,877,943号。英国特許1,466,201 号、同1,469,117号、同1,422,057号、特公平3-10391 号、同6-52387号、特開平5-341432号、同6-194781号、 同6-301141号に記載されたような既知の色素から適当に 選択してよい。

【0237】本発明に用いられる色素の構造として特に 好ましいものは、チオエーテル結合含有置換基を有する シアニン色素(例としては特開昭62-58239号、同3-13863 8号、同3-138642号、同4-255840号、同5-72659号、同5-72661号、同6-222491号、同2-230506号、同6-258757 号、同6-317868号、同6-324425号、特表平7-500926号、 米国特許5,541,054号に記載された色素)、カルボン酸 基を有する色素(例としては特開平3-163440号、6-30114 1号、米国特許5,441,899号に記載された色素)、メロシ アニン色素、多核メロシアニン色素や多核シアニン色素 (特開昭47-6329号、同49-105524号、同51-127719号、同 52-80829号、同54-61517号、同59-214846号、同60-6750 号、同63-159841号、特開平6-35109号、同6-59381号、 同7-146537号、同7-146537号、特表平55-50111号、英国 特許1,467,638号、米国特許5,281,515号に記載された色 素)が挙げられる。

【0238】また、J-bandを形成する色素として米国特許5,510,236号、同3,871,887号の実施例記述の色素、特開平2-96131号、特開平3-48753号が開示されており、本発明に好ましく用いることができる。

【0239】これらの増密色素土単純に用いてもよく、 2種以上組合せて用いてもよい、増密色素の組合せは特 に、強空増聚の目的でしばしば用いられる、増密色素と ともに、それ自身分光増密作用をもたない色素あるいは 可規光を実質的に吸収しない物質であって、強色増密を 示す物質を到率に合んでもよい、有用な増配金素、 色増端を示す色素の組合せおよび強色増密を示す物質は Research Disclosure/176後176/31(1978年12月第7月 第23 買収の幻境、あらいは特念短49~25500号、同時2~933号、特別報号9-19032号、同野-1922化号等に記載されてい [0240]本界明に用いられる増発色素は2種以上を 併用してもよい。増築色素をハロゲン化部別制中に液加 させるには、それらを直接判別中に分散してもよいし、 あるいは木、メタノール、エタノール、プロパノール、 アセトン、メチルセロソルブ、2.2.3・テトラフルト プロパノール、2.2.2・トリフルオロエタノール、3・メト キシー・プロバノール、8・メント・ブタノール、1・メト トキシー・プロバノール、8・ドンナ・アメトルホルムアド の溶膜の単独もしくは混合溶媒に溶解して乳刺に流加して

【0241】また、米国特許3,469,987号明細書等に開 示されているように、色素を揮発性の有機溶剤に溶解 し、この溶液を水または親水性コロイド中に分散し、こ の分散物を乳剤中へ添加する方法、特公昭44-23389号、 同44-27555号。同57-22091号等に開示されているよう に、色素を酸に溶解し、この溶液を乳剤中に添加した り、酸または塩基を共存させて水溶液として乳剤中へ添 加する方法、米国特許3.822.135号、同4.006.025号明細 書等に開示されているように界面活性剤を共存させて水 溶液あるいはコロイド分散物としたものを乳剤中に添加 する方法、特開昭53-102733号、同58-105141号に開示さ れているように親水性コロイド中に色素を直接分散さ せ、その分散物を乳剤中に添加する方法、特別昭51-746 24号に開示されているように、レッドシフトさせる化合 物を用いて色素を溶解し、この溶液を乳剤中へ添加する 方法を用いることもできる。また、溶解に超音波を用い ることもできる。

【0242】本発明に用いる増感色素を本発明のハロゲ ン化銀乳剤中に添加する時期は、これまで有用であるこ とが認められている乳剤調製のいかなる工程中であって もよい。例えば米国特許2,735,766号、周3,628,960号、 同4,183,756号、同4,225,666号、特開昭58-184142号、 同60-196749号等の明細書に開示されているように、ハ ロゲン化銀の粒子形成工程または/および脱塩前の時 期、脱塩工程中および/または脱塩後から化学熟成の開 始前までの時期、特開昭58-113920号等の明細書に開示 されているように、化学熱成の直前または工程中の時 期、化学熟成後、途布までの時期の乳剤が塗布される前 ならばいかなる時期、工程において添加されてもよい。 また、米国特許4.225.666号、特開昭58-7629号等の明 細書に開示されているように、同一化合物を単独で、ま たは異種構造の化合物と組み合わせて、例えば粒子形成 工程中と化学熟成工程中または化学熟成完了後とに分け たり、化学熟成の前または工程中と完了後とに分けるな どして分割して添加してもよく、分割して添加する化合 物および化合物の粗み合わせの種類を変えて添加しても EU.

【0243】本発明における増盛色素の使用量としては 感度やカブリなどの性能に合わせて所望の量でよいが、 画像形成層である感光件層のハロゲン化線1モル当たり1 0-6~1モルが好ましく、10-4~10-1 モルがさらに好まし

【0244】本発明におけるハロゲン化銀乳剤または/ および有機銀塩は、カブリ防止剤、安定剤および安定剤 前駆体によって、付加的なカブリの生成に対して更に保 護され、在庫貯蔵中における感度の低下に対して安定化 することができる。単独または組合せて使用することが できる適当なカブリ防止剤、安定剤および安定剤前駆体 は、米国特許第2.131.038号および同第2.694.716号に記 載のチアゾニウム塩、米国特許第2,886,437号および同 第2,444,605号に記載のアザインデン、米国特許第2,72 8,663号に記載の水銀塩、米国特許第3,287,135号に記載 のウラゾール、米国特許第3,235,652号に記載のスルホ カテコール、英国特許第623,448号に記載のオキシム、 ニトロン、ニトロインダゾール、米国特許第2,839,405 号に記載の多価金属塩、米国特許第3,220,839号に記載 のチウロニウム塩、ならびに米国特許第2,566,263号お よび同第2,597,915号に貯載のパラジウム、白金および 金塩、米国特許第4,108,665号および同第4,442,202号に 記載のハロゲン置換有機化合物、米国特許第4,128,557 号および同第4.137.079号、第4.138.365号および同第4、 459,350号に記載のトリアジンならびに米国特許第4,41 1,985号に記載のリン化合物などがある。

[0245] 本郷門に好きしく用いられるカブリ防止剤 は有機ハロゲン化物であり、例えば、特開間50-119504 号、同50-12028号、同51-121323号、同54-58020号、同 55-70528号、同56-93339号、同59-90842号、同61-12264 号、同62-129845号、特開FF-03019号、同75-72781号、同61-5809号、米国特許第5340712号、同56900号、原164737号に開示されているよう文化合物が 挙げられる。

【0247】本祭明を実施するために必要ではないが、 画像形成層にカブリ防止列として小線(11)塩を加えるこ とが再利なことがある。この目的に結ましいか線(11)塩 は、酢酸水銀および臭化水銀である。本発明に使用する 水銀の添加量としては、塗布された線1モル当たり好ま しくは10モルー10モル、さらに好ましくは10モルー-100 μαモルの範囲である。

【0248】本発明の熱現像画像記録材料は高感度化や カブリ防止を目的として妄思番散類を含有しても良い。 本発明の安息香散類はいかなる妄思香酸誘導へももい が、好ましい構造の例としては、米国特許4,784,939 号、同4,152,160号、特膜平8-15124号、同8-151241

号、同8-98051号などに記載の化合物が挙げられる。本

【0249】本発明には現像を抑制あるいは促進させ現 像を削削するため、分光増吸効率を向上させるため、現 億前後の保存性を向上させるためなどにメルカプト化合 物、ジスルフィド化合物、チオン化合物を含有させるこ とができる。

【0250】本発明にメルカプト化合物を使用する場 今、いかなる横浩のものでも良いが、Ar-SM 、Ar-S-S-A rで表されるものが好ましい。式中、Mは水素原子または アルカリ金属原子であり、Arは1個以上の窒素、イオ ウ、酸素、セレニウムもしくはテルリウム原子を有する 芳香環基または縮合芳香環基である。好ましくは、これ らの基中の複素芳香環はベンズイミダゾール、ナフスイ ミダゾール、ベンゾチアゾール、ナフトチアゾール、ベ ンズオキサゾール、ナフスオキサゾール、ベンゾセレナ ゾール、ベンゾテルラゾール、イミダゾール、オキサゾ ール、ピラゾール、トリアゾール、チアジアゾール、テ トラゾール、トリアジン、ピリミジン、ピリダジン、ピ ラジン、ピリジン、プリン、キノリンまたはキナゾリノ ンである。この複素芳香環は、例えば、ハロゲン(例え ば、BrおよびCl)、ヒドロキシ、アミノ、カルボキシ、 アルキル(例えば、1個以上の炭素原子、好ましくは1~4 個の炭素原子を有するもの)およびアルコキシ(例えば、 1個以上の炭素原子、好ましくは1~4個の炭素原子を 有するもの)からなる置換基群から選択されるものを有 してもよい。メルカプト置換複素芳香族化合物をとして は、2-メルカプトベンズイミダゾール、2-メルカプトベ ンズオキサゾール、2-メルカプトベンゾチアゾール、2-メルカプト-5-メチルベンズイミダゾール、6-エトキシ-2-メルカプトベンゾチアゾール、2,2'-ジチオビス-ベン ゾチアゾール、3-メルカプト-1.2.4-トリアゾール、4.5 -ジフェニル-2-イミダゾールチオール、2-メルカプトイ ミダゾール、1-エチルー2-メルカプトベンズイミダゾー ル、2-メルカプトキノリン、8-メルカプトプリン、2-メ ルカプト-4(3H)-キナゾリノン、7-トリフルオロメチル-4-キノリンチオール、2,3,5,6-テトラクロロ-4-ピリジ

ンチオール、4アミノ-6-ヒドロキシ-2-メルカアトビリ ミジンモノヒドレート、2アミノ-5-メルカプト-1.3.4 ナアジアゲール、3-アミノ-5-メルカプト・12、9-ナアジア・ル、3-アミノ-5-メルカプトビリ ミジン、2-メルカプトビリミジン、4-メルカプトビリ ミジン、2-メルカプト-4-ズールビリミジンとドウロ リド、3-メルカプト-5-フェニル-1.2.4トリアゾール、 2-メルカプト-4-ブニルオキヴィールなどが挙げられ るが、本事明によわない。

【0251】これらのメルカアト化合物の添加量として は画像形成層である乳剤層中に銀1モル当たり0.0001~ 1.0モルの範囲が好ましく、さらに好ましくは、銀の1モ ル当たり0.001~0.3モルの量である。

[0252]本邦明における悪光性層等の面像形成層に は、可塑剤および高溶剤として多価アルコル(例え ば、米田静計和2、960、444号に記載された意類のグリセ リンおよびジオール)、米国特計第2,588,765号および同 第3,121、665号に記載の脂肪酸まだはエステル、英国特 計算955,661号に記載のシリコーン樹脂などを用いるこ とができる。

【0253】本発明の熱現像写真用乳剤は、支持体上に 一またはそれ以上の層に含有される。一層の機成は有機 銀塩、ハロゲン化銀、現像剤およびバインダー、ならび に色調剤、被覆助剤および他の補助剤などの所望による 追加の材料を含まなければならない。二層の構成は、第 1乳剤層(通常は支持体に隣接した層)中に有機銀塩およ びハロゲン化銀を含み、第2層または両層中にいくつか の他の成分を含まなければならない。しかし、全ての成 分を含む単一乳剤層および保護トップコートを含んでな る二層の構成も考えられる。多色感光性熱現像写真材料 の構成は、各色についてこれらの二層の組合せを含んで よく、また、米国特許第4.708.928号に記載されている ように単一層内に全ての成分を含んでいてもよい。多染 料多色感光性熱現像写真材料の場合、各乳剤層は、一般 に、米国特許第4,460,681号に記載されているように、 各乳剤層(感光性層)の間に官能性もしくは非官能性の バリアー層を使用することにより、互いに区別されて保 持される。

[0254]本祭明の画像表版層である感光性層には色調改良、イラジエーション防止の観点から各種染料や類料を用いることができる。本発明の感光性層に用いる染料さなび原料はいかなるものでもよいが、例えばガラーインアックス記載の顔料や染料があり、具体的にはどラゾロアゲール染料、アントラキノン染料、オンドン学科、インドアーリン染料、インドアニリン染料、インドアニリン染料、インドアニリン染料、インドアニリン染料、インドアニリン染料、インドアニリン染料、インドアニリン染料、インドアニリン染料、インドアニリン染料、インドアニリン染料、インドアニリン染料、インドアニリン染料、インドアニリン染料、インドフェグール染料。アクロシアニンをはどめとする有機原料、無機原料などが挙げられる。本発明に用いられる好ましい染料としてはアントラギノン、染料(例えば時期等で344は「音な戦の化合物」で、特開

平5-165147号記載の化合物3-6~18および3-23~38な ど)、アゾメチン染料(特開平5-341441号記載の化合物17 ~47など)、インドアニリン染料(例えば特開平5-289227 号記載の化合物11~19、特開平5-341441号記載の化合物 47. 特開平5-165147号記載の化合物2-10~11など)およ びアゾ染料(特開平5-341441号記載の化合物10~16)が挙 げられる。これらの染料の添加法としては、溶液、乳化 物、固体微粒子分散物、高分子媒染剤に媒染された状態 などいかなる方法でも良い。これらの化合物の使用量は 目的の吸収量によって決められるが、一般的に感材 1㎡ 当たり1µg以上1g以下の範囲で用いることが好ましい。 【0255】本発明においてはアンチハレーション層を 感光性層に対して光源から遠い側に設けることができ る。アンチハレーション層は所望の波長範囲での最大吸 収が0.3D1 F2D1下であることが好ましく、さらに好まし くは0.5以上2以下の露光波長の吸収であり、かつ処理後 の可視領域においての吸収が0.001以上0.5未満であるこ とが好ましく、さらに好ましくは0.001以上0.3未満の光 学濃度を有する層であることが好ましい。

【0256】本発明でハレーション防止染料を使用する 場合、こうした染料は波長範囲で目的の吸収を有し、処 理後に可視領域での吸収が充分少なく、上記アンチハレ ーション層の好ましい吸光度スペクトルの形状が得られ ればいかなる化合物でも良い。例えば以下に挙げるもの が開示されているが本発明はこれに限定されるものでは ない。単独の染料としては特開昭59-56458号、特開平2-216140号、同7-13295号、同7-11432号、米国特許5,380, 635号記載、特開平2-68539号公報第13頁左下欄1行目か ら同第14頁左下欄9行目、同3-24539号公報第14頁左下欄 から同第16頁右下欄記載の化合物があり、処理で消色す る染料としては特開昭52-139136号、間53-132334号、同 56-501480号、同57-16060号、同57-68831号、同57-1018 35号、同59-182436号、特開平7-36145号、同7-199409 号、特公昭48-33692号、同50-16648号、特公平2-41734 号、米国特許4.088,497号、周4.283,487号、周4.548,89 6号、同5.187.049号がある。

[0257]本発明における熱現像画像記録材料は、支 持体の一方の側に少なくとも1層のハロゲン化銀用網を 含む感光性層のような画像形成層を有し、他方の側にバ ック層(バッキング層)を有する、いわゆる片面画像記 録材料であることが好ましい。

【0258】本売明においてバック周は、所留の放長範囲での最大研究が0.3以上2以下であることが好ましく、 さらに好ましくは3.5以上2以下であることが好ましく、 さらに好ましくは3.5以上2以下の吸収であり、かっ処理 後の可採倒域においての収収が0.0以上0.5未満であ ことが好ましく、さらに哲ましくは0.0以上0.3未満の 光学満度を有する層であることが好ましいまた、バッ ク層に用いるバレーション加止境料の例としては前述の アンテントルーション側と同じである。

【0259】米国特許第4,460,681号および同第4,374,9

21号に示されるような裏面抵抗性加熱層(backside resi stive heating layer)を感光性熱現像写真画像系に使用することもできる。

【0260】本発別の商像形成層、保護層、バック層な ど各層には硬膜剤を用いても良い。硬膜剤の例として は、米国特許4,281,060号、特開平6-20819号をとに記 数されているボリイソシアネート類、米国特許4,791,04 2号などに記載されているエポキシ化合物類、特期服52-99048号などに記載されているビニルスルホン系化合物 類などが用いられる。

【0262】本発明の無環像画像記録材料の前途の熱現 像時の寸法定化による処理ムラを防止する方法として、 めた以上に15で未満(併ましくは1315公以下)の過度で画 像が出ないようにして5秒以上加熱した後、110℃以上 (好ましくは130℃以下)で禁現像して画像形成させる 方法(いよゆるを段階加速がようが有效である。

【0263】本発明の簡潔正婚材料はいかなる方法で露 光されても良いが、電光光源としてレーザー光が好ましい。本発明によるレーザー光としては、ガスレーザー、 VAGレーザー、色素レーザー、半導体レーザーなどが好ましい。また、半導体レーザーと第2高調波発生素子などを用いることもできる。

【0264】本発明の画像記録材料は鑑光時のヘイズが 低く、干渉議が発生しやすい傾向にある。この干渉終発 生防止技術としては、特開平5-11548号などに開示され ているレーサー光を画像記録材料に対して始めに入光さ せる技術や、W95/31751号などに開示されているマルチ モードレーザーを利用する方法が知られており、これら の技術を用いることが移ましい。

【0265】本発明の画像記録材料を露光するにはSPIE vol. 169 Laser Printing 116-128頁(1979)、特朗平4-5 1043号、MO95/31754号などに開示されているようにレーザー光が重なるように雑光し、走査線が見えないようにすることが好ましい。

【0266】本発明の熱現像画像記録材料の熱現像処理 に用いられる熱現像機の一構成例を図1に示す。図1は 熱類議権の側面図を示したものである。内部に加熱手段の無限として、ハロゲンランブ1を収納した円筒次のセトドラム 20両面に複数個の送りローラー3に懸禁された脱池用のエンドレスベルト4が圧衰され、エンドレスベルト4とヒートドラム2との間に無規模面積配置材5分は表するで、強される間に無対視面積配置が対5分は、現像温度まで加熱され、無現保が行われる。この場合、ランプの配向は最速化され、無現保が行われる。この場合、ランプの配向は最速化され、概方向の温度制理が必要化くがわれる。

【0267】ヒートドラム2とエンドレスペルト4の間から祭現機画破産婦材料5が送り出される出口6付近 た、ヒートドラム2の周面の湾曲から開放された熱現像 形成材料5を平雨状に施正する横正がイド板7分號付ら れている。この矯正がイド板7付近において、熱現像画 機能機材料5の温度が所度の温度以下にならないように 空間飛温度を影響してある。

【0268】出口のア家には熱現像画像記録材料5を 送る1対の送りローラー8が設置され、を下落にはロ ーラー対名に限度して、熱現像画質素記録材料5を平面状 に維持した状態で案内する1対の平面がイド収りが設置 され、さらにその下流には平面がイド収りが設置 され、さらにその下流には平面がイド収りに開設しても う1対の送りローラー10が設置されている。この平面 がイド収りは熱場保面電影が材料5がその間を搬送され でいる間に熱現底跡材料5が成功と数がませ でいる。すなわち、その間に熱現像記録材料5の温 度が30で以下になるまで作曲される。この冷却手段と して、冷却ファン11が襲撃されている。

[0269]以上、図示に使って限明したが、これに限 らず、例えば特매ア・13294号に記載のものな と、本期明に用いられる無別金線は種々の相談のもので あってよい。また、多段階加級方法を実施する場合は、 上述のような装置において、加熱温度の異なる影響を2 個以上設置し、连続的に異なる温度で加熱するようにす ればよい。

[0270]

【実施例】以下に、自己架橋性ラテックスの合成例とと もに実施例を示し、本発明を具体的に説明するが、本発 明は以下の実施例のみに限定されるものではない。

【0271】 <含歳例1ンマレイン化ボリー1、2・プタジェン (日本書達 (株) ※1 NLS90+P8 BM-1015) 10.0kg・ブナルセロソルグ2.5g、ブタノール0.5g、木だ08g、25 重量%アンモニアル2.3を加え、サービ溶解させた。7 つじに加熱し、通磁散カリカム0.215を水の8に溶解した、夜を添加し、遮海泉流下、メタクリル種ブチルの8を2時間かけて添加した。1時間、乳化蛋合した後、通磁散カリウム0.10s部を水10sに溶解した液を添加し、8 0℃で3時間加速した。乳白色の長好なデテックスが得られた。得られたデテックスが得られた。得られたデテックスは785。1面形分流度22、4重量 ※ 平均解890m (米衡低法)であった。

【0273】 〈金茂州3ン水110gにドデシルベンセンス ルホン酸ソーグ18、1 N水酸化ナトリウム水溶液体を流 加した液を70℃に加熱し、通流酸カリウムの 25g を水 20%に溶解した液を流加し、端素気流下、メタクリル酸 メチル45、0gとN・メチロールアクリルアミド5.0g、メタ ノール5g、水5の混合物を20時間かけて添加した。1時間、現化重合した後、過硫酸カリウム0.12gを水10gに溶 解した液と1 N水酸化ナトリウム水溶液0.1gがを添加した。15kので3万分で 10、80℃で3時間加熱にた。その後、ラテックスを室 温まで飲冷し、液の中が5.5~7.0になるよう0.1 N水 酸化ナトリウム水溶液2 6kg に加えた。これによって自 セのラテックスが終られた、得られたラックス12hd6.8。間形分濃皮5.7重量%、平均粒径129μm (光散乱 法)であった。その他の自己架橋性ポリマーラテックス 日間隊にして合成した。

【0274】<実施例1>

《ハロゲン化銀乳剤の調製》

(乳剤A) 水穴の31にゼラチン (カルシウム含有量として2700ppa) 118および泉化カリウム30gg、ベンゼンチオスルネン酸ナリウム10gg、溶解性 (直接55)にて戸地を5.0に合わせた後、研整線18.63を含む水溶液159alと異化カリウムを1モル/リットルで含む水溶液50分配間かけて添加した。ついて、研整線55.53を含む水溶液476alと異化カリウムを1モル/リットルで含むパコケン塩水溶液をかりて、28分30時間かけて添加した。ついて、研整線55.53を含む水溶液476alと異化カリウムを1モル/リットルで含むパコゲン塩水溶液をかけ、254分30時間かけて添加した。その後94を下げて凝集沈隆させて脱塩処理をし、化合物Aを0.17g。脱イオンゼフチン(カルウム合有量として200ps以下)23.7g加え、9店5.9、pk8.0に調整した。得られた粒子は平均粒子サイズ0.11μa。投影面積突動所表別、(100)面比率93とか立方体積子であった。

【0275】こうして得たハロゲン化銀粒子を60°Cに昇温して銀1モル当たりベンゼンチオスルホン酸ナトリウムルでルモルを添加し、3分後にチオ硫酸ナトリウム154ムモルを添加して、100分熟成した。

【0276】その後、40℃に温度を保ち、ハロゲン化級 1モルに対して6.4×10°4モルの増懲色素A、6.4×10°3 セルの化合物Bを撹拌しながら添加し、20分後に30℃に 急冷してハロゲン化銀乳剤Aの調製を終了した。

[0277]

【化13】

増感色素A

【0278】《有機酸銀分散物の調製》

<有機酸銀A>アラキン酸4.4g、ベヘン酸39.4g、蒸留 zk700ml tert-ブタノール70mlを85Cで指揮しながら1N -NaOH水溶液103m1を60分かけて添加し240分反応させ、7 5℃に降温した。次いで、硝酸銀19.2gの水溶液112.5ml を45秒かけて添加し、そのまま20分間放置し、30°Cに降 温した。その後、吸引沪過で固形分を沪別し、固形分を 沪水の伝導度が30μS/cmになるまで水洗した。こうして 得られた固形分は、乾燥させないでウエットケーキとし て取り扱い、乾燥固形分100g相当のウエットケーキに 対し、ポリビニルアルコール(商品名: PVA-205)5gおよ び水を添加し、全体量を500gとしてからホモミキサー にて予備分散した.

【0279】次に予備分散済みの原液を分散機(商品 名:マイクロフルイダイザーM-110S-EH、マイ クロフルイデックス・インターナショナル・コーポレー ション製、G10Zインタラクションチャンバー使用) の圧力を1.75 Okg/cm²に調節して、三回処理し、右機 酸銀分散物Aを得た。こうして得た有機酸銀分散物に含 まれる有機酸銀粒子は平均短径0.04µm、平均長径0.8µ m. 変動係数30%の針状粒子であった。粒子サイズの測定 は、Malvern Instruments Ltd. 製MasterSizerXにて行っ た。冷却操作は蛇管式熱交換器をインタラクションチャ で所望の分散温度に設定した。 【0280】 《1.1-ビス(2-ヒドロキシ-3.5-ジメチルフ ェニル)-3.5.5-トリメチルヘキサンの間体微粒子分散物

ンバーの前後に各々装着し、冷媒の温度を調節すること

の調製》1.1-ビス(2-ヒドロキシ-3.5-ジメチルフェニ ル)-3.5.5-トリメチルヘキサン20gに対してクラレ(株) 製MPポリマーのMP-203を3.0gと水77m1を添加してよく 攪拌して、スラリーとして3時間放置した。その後、0.5 mmのジルコニアビーズを360x用意してスラリーと一緒に ベッセルに入れ、分散機 (1/4Gサンドグラインダーミ ル:アイメックス(株)製) にて3時間分散し環元割固体 微粒子分散物を調製した。粒子径は、粒子の80wt%が0.3 μπ以上1.0μμ以下であった。

【0281】《トリプロモメチルフェニルスルホンの問 体微粒子分散物の調製》トリプロモメチルフェニルスル ホン30gに対してヒドロキシプロビルメチルセルロース 0.5g、化合物C0.5gと、水88.5gを添加し良く惰拌して スラリーとして3時間放置した。その後、海元割団体微 粒子分散物の調製と同様にしてカブリ防止剤の固体微粒 子分散物を調製した。粒子径は、粒子の80wt%が0.3μm 以上1.0 m以下であった。

[0282]

【化14】

ÇH₃ O.-(CH₂CH₂O)n −H H-(QCH2CH2)m-Q 化合物C m+n=27

【0283】《画像形成層塗布液の調製》上記で調製し た有機酸銀Aの銀1モルに対して、

バインダー:SBRラテックス LACSTAR 3307B 間形分 量470g(大日本インキ化学工業(株)製)

1,1-ビス(2-ヒドロキシ-3,5-ジメチルフェニル-3,5,5-トリメチルヘキサン)

1,1	CX(2 C 11-(3 3,3 33.7)	107 2010 3,3,3 1 37,770 (1,90)
		110g
	活性剤;化合物D	58
	ブロモメチルフェニルスルホン	
ベン	ゼンチオスルホン酸ナトリウム	0.25g
親水	性ポリマー ; 化合物E	46g
6-is	o-ブチルフタラジン	0.12moI
造核	剤;化合物F	1.8g
化合	物G	6.5g
化合	物H	8.5g
染料	A	0.62g
ハロ	ゲン化銀乳剤A	Ag量として 0.05mol
を添加し、水を加え、更	こ1 N硫酸でpH6.5に調製し、	[0284]
画像形成層塗布液を得た。		【化15】
化合物	C ₉ H ₁₉ — ⟨	-O-+CH ₂ CH ₂ -O-+3-(CH ₂) ₄ SO ₃ Na
	* <u> </u>	1 2 2 73 1 27 0
No A Not		
化合物图	C ₁₂ H ₂₅ S(CH ₂	-ÇH)₂₈₄ - (CH₂—ÇH) ₃₆ H
		ÒH COOH
	, HO	
	1	
化合物F	0~~0	化合物G
	N-NH	•
	~ ```````	CH ₈ COONH ₄
	<u> </u>	Y
	<u></u>	
	NHCOCH₂O—	COONH ₄
		/ l
		
	Ĺ	
	,	>
	/ ÇH₃	OH \
	. /cH	C00. /
化合物	1 / [Sin [1
		Zn ²⁺
	Į.	ĊH−CH₃ / ² "
	1	↓ ° /
	\	î /
	\) / 2
		0.
染料A	Ŷ	ΙΫ́
	HN	NH
		1
	o No	0 N O (C₂H₅)₃NH
		(02/16/3/4/1
	//	~

【0285】《乳剤面保護層塗布液の調製》合成例1の ラテックス180gに化合物 I を0.125g、カルナパワックス (中京油脂(株)製;セロゾール524)30wt%溶液2.

5g、ポリビニルアルコール (クラレ (株) 製; PVA-23 5) 2.3gおよびマット剤 (ポリメテルメタクリレート,平 均粒径5μm) 0.5gを加えて塗布液を調製した。

[0286] 300℃で溶融後T型ダイから押し出し、その後急冷 [4k.16] し、熱固定後の膜厚が120μmになるような厚みの未延 化合物 C₈F₁₇SO₂NCH₂COOK 伸フイルムを作成した。 【0288】これを周速の異なるロールを用い、3.3倍 に縦延伸、ついでテンターで4.5倍に横延伸を実施し た。このときの温度はそれぞれ、110°C、130°Cであっ 【0287】《バック/下途り層のついた門丁支持体の た。この後、240℃で20秒間熱固定後これと同じ温度で 作成》 横方向に4%緩和した。この後、テンターのチャック部を (1) 支持体 スリットした後、両端にナール加工を行い、4.8kg/cm2 テレフタル酸とエチレングリコールを用い、常法に従 で巻きとった。このようにして、幅2.4m、長さ3500m、 い、IV (固有粘度)=0.66 (フェノール/テトラクロ 厚み120μmのロールを得た。 ルエタン=6/4 (重量比) 中25℃で測定)のPETを [0289] 得た。これをペレット化した後、130℃で4時間乾燥 (2)下塗り層(a) ポリマーラテックスーの スチレン/ブタジエン/ヒドロキシエチルメタクリレート/ジビニルベンゼン =67/30/2.5/0.5 (重量%) 160ng/n2 2.4-ジクロロ-6-ヒドロキシ-s-トリアジン 4mg/m² マット剤 (ポリスチレン、平均粒子径2.4µm) 3mg/m² [0290] (3)下途り層(b) アルカリ処理ゼラチン (Ca2+含量30ppm、ゼリー強度230g) 50mg/m² [0291] (4) 進電屋 ジュリマーET-410 (日本純薬 (株) 製) 96mg/m² ゼラチン 50mg/m² 化合物A $0.2mg/m^2$ ポリオキシエチレンフェニルエーテル 10mg/m² スミテックスレジンM-3 18mg/m² (水溶性メラミン化合物 住友化学工業(株)製) 绕料A 780nmの光学濃度が1.0になる途布量 SnO₂/Sb (9/1重量比、針状微粒子、長軸/短軸=20~30 石原産業(株)製) 160ng/m² マット剂(ポリメチルメタクリレート、平均粒子径5μm) $7mg/m^2$ [0292] (5)保護層 ポリマーラテックスータ (メチルメタクリレート/スチレン/2-エチルヘキシルアクリレート/ 2-ヒドロキシエチルメタクリレート/アクリル酸 =59/9/26/5/1(重量%の共重合体)) 1000mg/m²

ポリスチレンスルホン酸塩(分子景1000~5000)

(水溶性メラミン化合物 住友化学工業(株)製)

セロゾール524(中京油脂(株)製)

スミテックスレジンM-3

【0293】支持体の片側に下塗り層(a)と下塗り層(b)を順次途布し、それぞれ180℃、4分間乾燥した。ついで、下塗り層(a)と下塗り層(b)を塗布した反対側の画に端電層と保護層を順次塗布し、それぞれ180℃、30秒間、乾燥してバック/下塗り層のついたP町支持体を作成し

て、 【0294】このようにして作成したバック/下塗り層 のついたPET支持体を150℃に設定した全長30mの熱処理 ゾーンに入れ、張力14g/cm²、搬送速度20m/分で自重搬 送した。その後、40℃のゾーンに15時間消し、10kg/cm²

2.6mg/m²

 $25 ng/n^{2}$

218ng/n²

て熱現像画像記録材料の試料番号3を作成した。

製》に用いる合成例1のラテックスの替わりに合成例3

のラテックスを175g用いた他は、試料番号1と同様にし

【0298】試料番号1の《乳剤面保護魔途布済の調

製》に用いる合成例1のラテックスの替わりにメチルメ

タクリレート/スチレン/2-エチルヘキシルアクリレー

ト/2-ヒドロキシエチルメタクリレート/アクリル酸=59

の巻き取り張力で巻き取った。

【0295】《熱理係面像形成材料の調製》前記バック /下塗り層(a)、下塗り層(b)がついたPET支持体の、下 途り層(a) 下途り層(b)のついた側に前記面像形成層お よびその上に前記引剤面保護層を塗布銀量1.6g/m²、保 護層のポリマーラテックスの固形分の塗布量2g/m²にな るように同時に重層塗布し、乾燥温度65℃3分で乾燥 し、試料を作成した。これを試料番号1とする。

【0296】試料番号1の《乳剤而保護層塗布液の調 製》に用いる合成例1のラテックスの替わりに合成例2 のラテックスを180g用いた他は、試料番号1と同様にし て勢現像画像記録材料の試料番号2を作成した。

【0297】試料番号1の《乳剤面保護層塗布液の調

/9/26/5/1(重量型)のポリマーラテックス (固形分濃度44 重量%) 95.3gを用い、造膜助剤として化合物」を6.7g 用いた他は、試料番号1と同様にして熱現像画像記録材 料の試料番号4(比較例)を作成した。

[0299]

【化17】

CH₂

【0300】得られた試料について、下記に示す評価法 に従って、写真性、熱現像処理適性およびオペーク適性 を評価した。

【0301】(1)写真件能の評価

(露光処理)得られた試料を780nmにピークを有する干渉 フィルターおよびステップウェッジを介して、発光時間 10-6秒のキセノンフラッシュ光で露光した。

【0302】(熱現像処理)露光済みのサンプルを図1の 熟現像機にて117℃で20秒間熱現像処理を行った。な お、図1のドラム式熱現像機は、ランプの配光を最適化 し、幅方向の温度精度を±1℃で行った。また、矯正ガ イド板7付近において熱現像画像記録材料の温度が90

℃以下にならないように雰囲気温度を調整した。

【0303】(写真性能の評価)得られた画像の評価をマ クベスTD904満度計(可視濃度)により行った。測定の結 果は、Dmin、感度(Dminより1.0高い濃度を与える露光量 の比の逆数)、コントラストで評価した。コントラスト は露光量の対数を横軸として、濃度0.3と3.0の点を結ぶ 直線の傾きで表した。

【0304】(2)熱現像処理適性

図1の熱現像機を用いて、画像形成層を有する面がヒー トドラム側になるように試料を涌して、ヒートドラムか らの試料の剝離のし易さを評価した。○、△が実用上許 容されるレベルである。

- (): 自然に削離する。
- △: 剥離のキッカケを与えるとその後は自然に剥離す
- X:強制的に剥がす必要がある。
- 【0305】(3)オペーク適性

毛筆に、トルエンを含ませて、画像を形成した試料の画 像部を5~6回擦り、トルエンが乾いた後の画像の乱れ を評価した。○、△が実用上許容されるレベルである。

- (): 画像に変化なし。
- △:画像がやや乱れる。 ×: 画像が乱れ、膜破壊が生じている。
- その結果を表23に示す。
- [0306]

【表23】

表23

安全保護		写真性能			オペーク	
	相対感度*	コントラスト	Dmin	处理遍性	適性	
1(本発明)	100	13	0.10	0	0	
2(本発明)	100	. 13	0.10	0	0	
3(本発明)	100	13	0.10	Δ	О	
4(比較例)	100	13	0.10	×	×	

試料番号1の感度を100とした時の相対値

【0307】表23の結果から、保護層に自己架橋性ボ リマーラテックスを用いた記録材料は、写真性能を損な

うことなく、熱現像処理適性ならびにオペーク適性が良 好な熱現像画像記録材料であることがわかる。特に、マ レイン化ポリー1、2 ーブタジエンを放射とするポリマーラテックスを用いた場合は良好な特性を示す。
[0308] (実施例2)実施例1の試料器等4(比較例)の乳刺面保護層のポリマーラテックス(メチルメクリレート/スキレン/2 エチルペキシルアクリレート/アクリル酸・159/9/26/5/1(重量%))を計自ご架積性がリマーラテックスとして用い。合成例1-3で得られ

た自己架勝性ポリマーラテックスとの比(固形分の重量 比)を表24に示すように着えて乳利雨度振想を試料器 号4と開業にして形成する日かは実施例1の試料と同様 にして試料を作成した(表24)。これらの試料につい て実施例1と同様にして写真性能、無現像処理適性、オ ペーク適性の評価を行った。その結果を表24に示す。 [0309]

【表24】

表 2.4

46.24							
飲料番号	自己架橋性の ラテックス復	[自己架橋性ラテックス/非自己架橋性ラテックス*1 +自己架橋性ラテックス)]の過形分比(wt%)	写真性能			熱現像	オベーク
			相対感度**	コントラスト	Dmin	処理適性	遊性
21(比較例)	なし	0	100	18	0.10	×	×
22(本発明)	. 含成何 1	20	100	13	0.10	·×	Δ
23(本発明)	合成例 1	40	100	13	0.10	Δ	Δ
24(本発明)	合成例 1	60	100	13	0.10	O	0
25(本発明)	合成例 1	80	100	13	0.10	0	0
26(本発明)	合成例 1	100	100	18	0.10	0	О
27(本発明)	合成例 2	20	100	13	0.10	×	Δ
28(木芫明)	合成例 2	40	100	18	0.10	Δ	Δ
29(本発明)	合成例 2	60	100	18	0.10	0	0
80(本発明)	合成例 2	80	100	18	0.10	0	C
81(本発明)	合成例 2	100	100	18	0.10	0	С
32(本発明)	合成例 3	20	100	13	0.10	×	Δ
88(本発明)	合成例 3	40	100	13	0.10	Δ	Δ
84(本発明)	合成例 3	60	100	18	0.10	Δ	0
85(本発明)	合成例 3	80	100	13	0.10	Δ	0
86(本発明)	合成例 3	100 .	100	18	0.10	Δ	0

^{*1} メチルメタクリレート/スチレン/2ーエチルヘキシルアクリレート/2ーヒドロキシエチルメタクリレート/アクリル酸

【0310】表24から明らかなように、本発明の自己 架線性ボリマーラテックスを用いた試料は、写真性能を 接合うことなく、オペーク速性が良好であることがわか る。 【0311】さらに、自己架脈性ポリマーラテックスルと 使用量を金体のポリマーラテックスの40重量%以上と すると熱現像規則避性が良好になることがわかる。 【0312】<実施例3つ実施例2の試料番号26、3 1、36の試料の両後形成度のパインゲーの5BRラテックスの60世、および100世、などの10世、26世代と のラテックスにそれぞれ巻えて、試料を6種性成し、実 施列1と同様の評価をした、その結果、実施例2の対抗 する各試料と同様に、写真性能を損なうことなく、熱現 像処理或性、オペーク速性が良好であることがわかっ た。

[0313]

【発明の効果】本発明によれば、写真性能を良好にした

ままで、オペーク連性、さらには熱現像処理連性に優れた熱現像面像記録材料が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に用いる熱現像機の一構成例を示す側面 図である。

【符号の説明】

- 1 ハロゲンランプ
- 2 ヒートドラム
- 3 送りローラ
- 4 エンドレスベルト
- 5 熱現像画像記録材料
- 6 HI
- 7 ガイド板
- 8 送りローラ対
- 9 平面ガイド板
- 10 送りローラ対
- 11 冷却ファン

^{=59/9/26/5/1 (}重量%) のポリマーラテックス (実施例1の試料番号4 (比較例))

^{*2} 試料番号 21 の感度を 100 とした時の相対値



